高雄市仁武產業園區

產業用地(一)土地出租使用手冊

開發單位：高雄市政府

中華民國 115 年 10 月　編印

高雄市仁武產業園區
產業用地(一)土地出租使用手冊
目　　錄

第一部分　開發背景說明.....1
壹、仁武產業園區開發簡介.....2
第二部分　高雄市政府公告文件.....6
貳、高雄市仁武產業園區產業用地(一)第五次土地出租公告.....7
參、高雄市仁武產業園區產業用地(一)土地出租要點.....9
附件 3-1　仁武產業園區產業用地容許引進產業類別.....20
附件 3-2　仁武產業園區資源或污染物單位面積核配基準.....24
附件 3-3　仁武產業園區污水處理納管水質限值.....25
附件 3-4　仁武產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項.....26
附件 3-5　危害性化學物質清單.....36
附件 3-6　土地使用契約書.....58
肆、仁武產業園區土地使用分區管制要點.....64
伍、仁武產業園區產業用地(一)容積總量管制執行要點.....71
陸、仁武產業園區建築景觀預審規範.....74
柒、仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則.....88
第三部分　土地出租位置.....100
捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租位置.....101
第四部分　申租流程及應備書件.....103
玖、仁武產業園區產業用地(一)土地出租作業流程.....104
拾、指定繳款行庫帳戶一覽表.....105
拾壹、仁武產業園區產業用地(一)土地出租申請書件.....109

第一部分　開發背景說明

壹、仁武產業園區開發簡介

（一）開發緣起與目的

為因應高雄都會區持續發展、提升高雄港國際競爭力，並解決交通壅塞問題，交通部台灣區國道新建工程局爰經交通部指示於96～98年間進行「高雄港東側聯外高(快)速公路(國七)可行性研究案」，以健全高雄都會區整體高(快)速公路路網，並促進地區均衡發展。而前述可行性研究案前奉行政院於99年3月19日以院台交字第0990012487號函核復原則同意，按上開函示略以，國道7號建設應通盤考量並整合沿線及交流道周邊可發展利用土地，以發揮建設效益。

鑑於高雄地區產業發展需求殷切，加以高雄地區境內已開發工業區使用率已逾九成以上，可釋出供產業進駐設廠之產業用地幾已租售完罄，且多數屬開發達二十年以上之老舊工業區，公共設施供給不足，整體空間品質不良。復考量經濟時代轉變之背景下，過去高雄地區以傳統石化、煉鋼等重製造工業為主的「工業區」已漸漸式微，且大量引進產業投資、重視單一製造功能之園區模式已不敷時代所需，於兼具生產、生活及生態等複合產業功能並講求園區整體環境營造的「產業園區」應運而生下，新型產業園區除導入直接製程行為外，更將著重住宿餐飲、金融保險、專業技術服務業等支援型使用，以提供兼具生產與服務機能的投資環境。

是此，高雄市政府(以下簡稱市府)因應地方產業用地需求、為促進經濟與產業發展、加速產業轉型高值化，擬依前揭行政院函示內容，配合國道7號建設、按「產業創新條例」規定，於其沿線與國道10號仁武交流道周邊規劃開發高雄市仁武產業園區(以下簡稱本園區)。而本園區即本於顛覆傳統工業區形象並因應產業創新需求的理念進行規劃，期於融合周邊地景營造並以環境共生、低耗能低污染前提下，提供適量的產業用地及公共設施，促進重大交通建設及其周邊土地整合優化發展，並挹注產業群聚之經濟綜效。

（二）區位概述

1. 位置

本計畫基地位於高雄市仁武區國道10號仁武交流道周邊，計畫基地東北隅有觀音湖及仁武變電所，東側有仁武垃圾焚化廠、觀音山，西側為後安村社區。另計畫基地西距高鐵左營站約9.3公里，西南距高雄港約18.1公里、距小港機場約19公里，而鄰近產業聚落部分，西側及西北側各約2.7公里及4公里處則有仁武、大社等工業區。計畫範圍全區均為都市土地，屬「澄清湖特定區計畫」範圍內，原土地使用分區主要為農業區，並有部份道路用地(兼供高速公路使用)，位置詳圖1。

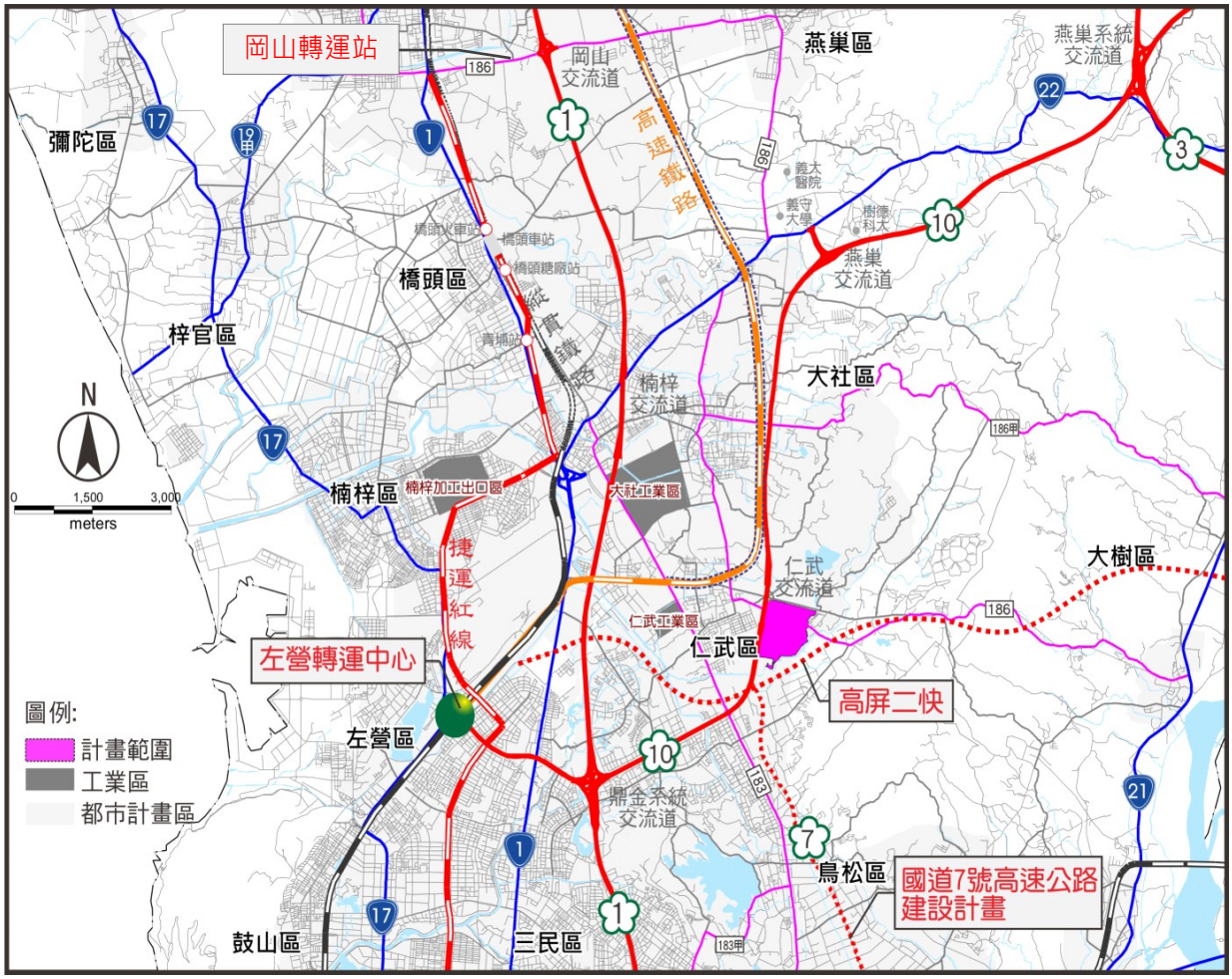


圖 1　仁武產業園區位置示意圖

2. 交通運輸

本園區位於國道 10 號仁武交流道旁，周邊聯外道路交通便利，計有國道系統(國 1、國 3 及國 10)、省道系統(臺 1 及臺 22)及市道系統(市道 183、市道 186)等。基地鄰近仁武交流道，藉由鼎金系統交流道可銜接國 1，以及利用燕巢系統交流道可轉往國 3，周邊聯外運輸發達。由基地經國道 10 號約 10 分鐘左右可達三鐵共構的左營站，不論是藉由捷運通往高雄市區或是搭乘台鐵、高鐵前往各城市皆甚為便利。

國道 7 號仁武系統交流道位於基地東南側處，未來可利用地方道路銜接至國道 7 號通往小港區，預期可藉海空港聯外功能的強化，帶動仁武產業園區及其沿線發展廊帶重啟南部經貿活力。

高屏二快是規劃中的台灣東西向快速公路之一。以左營高鐵為起點，至國道 3 號鹽埔交流道，計畫長度 24.8 公里，依據目前規劃路廊，本園區東南側設有仁武系統交流道及義大二路交流道。

3. 氣候

高雄市屬熱帶性季風氣候，終年高溫，冬季不甚明顯，降雨及風向變化則較明顯。年平均溫度約 25.1℃，月平均降雨量為 156.8 公厘，雨水集中於夏季 5～9 月，而冬季 10 月至翌年 3 月之雨量不及全年雨量之 10%。年平均日照時數約 2209.8 小時，高於台灣其他地區。

4. 人口與勞動力分析

依據高雄市政府主計處統計，高雄市及業人口數達總人口數之 45%以上，其中，以三級產業人口最多，二級產業人口為次，顯示工業區分布密集之高雄地區，過去雖然以二級產業為發展主力，惟近年隨經濟變遷，產業人口結構已轉向三級產業。為因應經濟時代的變革，本計畫除提供二級產業進駐之產業用地外，更將導入住宿餐飲、金融保險、專業技術等支援服務業，期為仁武地區挹注產業人口拉力。

（三）開發計畫

仁武產業園區面積約 74.05 公頃，產業用地占約 48.44 公頃、公共設施占約 25.6 公頃，以仁林路為界分二期開發，仁林路以南為第一期開發區，公共工程自民國 109 年 11 月開工，預計至 114 年底完成全區開發，並將提前點交土地供進駐廠商同步建廠。

（四）提供設施

1. 道路系統

仁武產業園區毗鄰之水管路與澄觀路為主要聯外道路，東西向及南北向貫穿計畫區之仁林路及新庄路，可串接園區主要旅次活動區塊及聯外道路，故將作為園區主要道路，串接主要旅次活動區塊及聯外道路，路寬以 25 公尺，配置雙向四車道為主；次要道路提供各主要旅次活動區塊與園區主要道路相銜接之服務功能，路寬以 16 公尺，配置雙向二車道為主。

因應園區運轉之停車需求，依都市計畫農業區變更使用審議規範，按範圍內服務人口車輛預估數之 20%設置公共停車場；總計本計畫劃設 4 處停車場用地，合計面積 1.58 公頃，佔全區總面積 2.14%。

2. 綠地及綠帶

本計畫於基地周界以寬約 10～20 公尺以上具隔離功能之綠帶或道路、水路等設施，隔離緩衝銜接周邊土地。其中，綠 1、綠 2、綠 3、綠 4 及綠 5 為都市計畫綠地用地(兼供道路使用)，因應工廠進出之可能需求，未來於經管理機關審核同意得設置進出口外，其餘均屬都市計畫綠地用地；而配合營運支援服務設施之設置需求，未來綠地用地另將視需要提供設置天然氣加（整）壓站…等公共設施或公用設備。總計本計畫劃設綠地面積共 3.53 公頃，佔全區總面積 4.76%。

3. 公園及滯洪池

本計畫劃設1處公園用地以保留部分台糖既有造林，面積0.98公頃，佔全區總面積1.32%。基地南側劃設1處公園兼滯洪池用地(面積5.55公頃，佔全區總面積7.49%)，期與既有南界外之獅龍溪區域滯洪池整合規劃，以形塑並創造園區成為兼具公園休憩、防洪等功能之綠色智能園區

4. 雨（排）水系統

配合既有排水現況與集水區，在降低土方需求之條件下採重力排水方式為原則。透過道路側溝收集系統，經由排水分線、支線及排水幹線，收集匯流至滯洪池，而後排放至獅龍溪。

5. 給水系統

本計畫基地地形東北高西南低，因應園區供水需求，於計畫區東北側毗鄰澄清湖特定區計畫焚化爐用地處劃設供水設施用地一處(面積0.43公頃，佔總面積0.58%)，設置配水池及相關管閥、加壓及機電設備，以提供產業園區運轉所需用水。

6. 電力系統

為確保園區能有充裕、可靠、品質良好之電力供應，並因應現有穿越基地高壓電塔之地下化需求，於計畫範圍內東南側鄰獅龍溪防汛道路劃設一處電力設施用地(面積約0.67公頃，約佔面積0.90%)，興建屋內型一次配電變電所及電路鐵塔，以供應園區高、低壓用戶用電以及地下化輸電線路連接區外系統。

7. 污水系統

滿足園區運轉衍生污水、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施需求，本計畫於計畫基地南界臨獅龍溪處劃設一處環保設施用地(面積約1.51公頃、約佔總面積2.03%)。

8. 公共服務設施

本計畫於基地北側劃設一處管理服務中心用地，面積0.58公頃，佔總面積0.78%，作為園區行政服務管理機構，並提供園區廠商及就業員工行政服務、會議、聯誼、小型展示及文化、休閒運動等設施。除滿足園區產業運轉之行政服務需求外，未來透過周邊公園、綠色園道等景觀軸線之整體規劃與串聯，將整合園區滯洪設施及獅龍溪景觀資源，提供園區就業員工、來訪遊客及鄰近住民一處休閒活動聚點。

第二部分　高雄市政府公告文件

貳、高雄市仁武產業園區產業用地(一)第五次土地出租公告

發文日期 中華民國 115 年 10 月 19 日
高市府經工字第 11535753401 號公告

主旨：公告辦理仁武產業園區產業用地(一)第五次土地出租作業，並自公告日起受理出租申請案件。

依據：

一、產業創新條例暨其施行細則。

二、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法。

三、本園區入區標準及用地使用規範，依各級都市計畫委員會及環境影響評估審查委員會決議內容予以規範。

公告事項：

一、本園區所有開發相關事項之公告、運作及執行，授權予本府經濟發展局（下稱本府經發局）為執行機關。

二、土地出租手冊（下簡稱手冊）及申請文件備索地點：請申請人自行於高雄市政府（以下簡稱本府）經發局網站（資訊專區-公告）下載（網址：https://gov.tw/giT）

三、出租對象：符合本園區容許引進產業類別(手冊附件 3-1)及資源或污染物核配基準(手冊附件 3-2)之廠商。

四、出租土地標示：詳本出租手冊「捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租位置」。

五、出租審查程序：申請案件由本府經發局委託開源營造股份有限公司初審，確認申請資料之完整性以及是否符合本園區容許引進產業類別和資源或污染物核配基準，後由本府經濟發展局審核確認；申請案件經審核文件不齊全或不符合本園區相關規定者，視為資格不符，無息退回申租保證金；申請案件經審核符合本園區相關規定者，由本府經濟發展局通知審查會議之舉辦辦法及時間。

六、應繳價款：申租保證金及完成使用保證金，詳本出租手冊「捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租面積及租金表」，審核符合規定者由本府經發局通知後限期繳納。

七、受理時間及方式：

（一）受理時間：自公告日起至 115 年 11 月 30 日止，於辦公日上午 8：30~下午 5：30 受理申請（例假日除外，中午 12 時至下午 1 時 30 分休息）。

（二）受理方式：申請人應依出租手冊規定提送相關文件，並以郵遞（請寬估郵件送達時間）或專人送交方式，於受理時間截止前寄（送）達本府經濟發展局工業輔導科(地址：高雄市苓雅區四維三路二號9樓)，逾期或申請書件缺漏皆不予受理。

八、完成使用之認定標準

（一）申請人應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承租土地面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於承租土地面積之20%，申請人符合前述標準者始符合完成使用之規定。申請人倘屬依法無需申請工廠登記者，應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得商業或營業登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承租土地面積之30%，始符合完成使用之規定。

（二）申請人未依規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，本府並得解除相關契約。

九、其他

（一）本公告如有未盡事宜，悉依本公告所依法規事項辦理；本府有增加、調整、變動或修改本公告內容之權利，如有其他未盡事宜，應由本府依相關法令釋疑之。

（二）凡對上開公告事項有疑問者，請向本府經發局（電話：07-3368333#3915）或開源營造股份有限公司（電話：02-87973567#1732，電子郵件：cms7@ceci.com.tw）洽詢。

參、高雄市仁武產業園區產業用地(一)土地出租要點

【法規依據】

一、 本要點依產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法規定訂定之。

二、 高雄市仁武產業園區（以下簡稱本園區）入區標準及用地使用規範依各級都市計畫委員會及環境影響評估審查委員會決議內容予以規範。

三、 本園區產業用地(一)土地（以下簡稱本區土地）之出租，依本要點規定辦理。本要點未規定者，依產業創新條例暨其施行細則、產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法及其他相關法令規定辦理。

【受理單位】

四、 本區土地出租相關事宜，由高雄市政府（以下簡稱本府）授權委託開源營造股份有限公司（以下簡稱開源公司）辦理。

【出租標的】

五、 本出租要點適用範圍為本園區產業用地(一)土地，詳本出租手冊「捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租位置」。

六、 本區土地之出租依本府規劃開發圖說辦理開發，並依規劃坵塊申請，申請人不得要求本府增設或變更任何公共設施；並應於申租時對公共設施尚未完成及現況情形充分了解，並同意日後不得就此等情形有任何額外要求或拒絕繳款。

【出租對象】

七、 本次出租對象為符合本園區容許引進產業類別(附件 3-1)及資源或污染物核配基準(附件 3-2)之廠商。

【出租程序】

八、 申請人應依本區土地出租公告所指定之時間、地點，檢齊下列申請書件一份及附件資料向本府經發局提出申請。

（一）申請書及承諾書

（二）投資營運計畫書：投資營運計畫書之內容，於日後雙方簽訂土地出租契約時，視為該契約之一部，申請人應依投資營運計畫書所載內容切實執行。

（三）用水回收計畫

（四）污染防治說明書

（五）繳納年租金 3%計算之申租保證金憑證影本，請向指定行庫帳戶繳

納取據（未附申租保證金繳納憑證影本或金額不足或不符規定繳交方式等，屬無法補正事項，視為資格不符，並不受理其申請）。

（六）申租土地位置圖。

（七）未登工廠原土地限期回復農用切結書。

九、 申請案件由開源公司初審後，由本府經發局審查確認，經審查符合本園區相關規定者，由本府經發局另行通知審查會議之舉辦辦法及時間。

十、 申請案件經審查文件不齊全或不符合仁武產業園區使用相關規定者，視為資格不符，無息退回申租保證金。

十一、 出租公告受理期間，如有二申請人以上申租同一土地坵塊且經本府經發局審查符合資格者，本府經發局將依申請人投資營運計畫書內容評定申租優先順位，必要時得邀集專家學者及相關機關參與審查會議，或請申請人配合出席簡報，決定各申請人之申租優先順位；第一順位申請人如未完成申租程序或放棄，得由第二順位以後之申請人依序遞補之。

入區審查會議之審核結果及優先順位，由本府經發局以書面通知各申請人。

十二、 前述第一順位或遞補之申請人，應洽開源公司進行申請書件之修正事宜，並應於本府經發局通知為第一順位或遞補者之日起1個月內修正完畢，未於期限內修正完畢者，本府經發局得視為放棄申租資格，並無息退還已繳交之申租保證金。

十三、 申請人於申租案核准後，應繳交完成使用保證金並與本府簽訂「仁武產業園區土地使用契約書」（以下簡稱土地使用契約），後與台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）簽訂「台糖公司土地設定地上權契約書」（以下簡稱地上權契約）並完成土地點交，始得向本府經發局申請無息退還已繳交之申租保證金；惟申請人經核准承租後，無故未依規定履行相關義務者，沒入本項保證金。

【申租保證金不予退還之事由】

十四、 申請人有下列情形之一者，本府經發局得撤銷其承租之核准，其原繳申租保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：

（一）申請人於接獲核准承租通知書後，無故未依規定履行相關義務者。

（二）逾期未繳清完成使用保證金。

（三）無正當理由未於本府經發局規定期限內與本府及台糖公司完成簽約、土地點交者。

【使用限制】

十五、 申請人同意確實遵照申租土地租售審查時所提出之「投資營運計畫書」於契約期限內盡其最大努力，具體實現該計畫之內容。但因產業發展趨勢、經濟變遷或其他企業營運考量，致需變更或調整「投資營運計畫書」之內容者，不在此限。

十六、 前點但書情形，於申請人提出變更或調整「投資營運計畫書」時，經本府以書面通知後，申請人應於期限內檢具具體事證及說明（如具公信力之第三單位之產業報告或調查）向本府專案報告。申請人逾期未提出相關說明者，視為違反土地出租契約之約定，經本府認定情節嚴重者，得解除土地使用契約並請台糖公司解除地上權契約。

十七、 申租土地上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記應以申請人為名義，申請人不得將申租之土地、興建之建築物及設施之全部或一部轉租、出租、出借或以其他方式供他人使用，但經本府與台糖公司書面同意者，不在此限；惟申請人如以此牟取不當利益，本府得解除土地出租契約並請台糖公司解除地上權契約，且追討其所得。

【名義變更之限制】

十八、 申請人自申請承租本區土地，除企業併購、依法更名外，不得變更申請人名義。

【完成使用認定標準】

十九、 申請人應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承租/購土地面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於承租/購土地面積之20%，申請人符合前述標準者始符合完成使用之規定。申請人倘屬依法無需申請工廠登記者，應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得商業或營業登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於承租/購土地面積之30%，始符合完成使用之規定。

二十、 申請人未依規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，本府並得解除土地使用契約並請台糖公司解除地上權契約。

二十一、因本園區公共設施尚未完成導致申請人無法施工而延誤工期，得申請展延完成使用期限，並由本府經發局認定之。

【土地租金】

二十二、依台糖公司規定辦理。

【土地租金調整計算】

二十三、依台糖公司規定辦理。

【應繳價款】

二十四、申請人承租本區土地應繳價款包含申租保證金及完成使用保證金，詳本手冊「捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租面積及租金表」。

【繳款方式】

二十五、申請人經審查核准承租土地者，應於本府經發局函送書面通知之次日起2個月內，向指定行庫帳戶繳納完成使用保證金。

完成使用保證金得以現金繳納、銀行定期存單質押或銀行連帶保證書方式為之。

完成使用保證金以銀行連帶保證書繳納者，有效期應自第一期租金繳交日起三年九個月。

二十六、申請人如因故延期繳款，應於價款繳款期限屆滿前向本府經發局提出申請，並切結負擔延遲期間之成本利息(按台灣銀行公告基準利率(按月)+2%計算)；應繳價款展延次數以1次為限，並不得超過2個月；逾期未繳清價款者，本府經發局得撤銷其承租之核准，原繳申租保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金。

【租賃期間】

二十七、依台糖公司規定辦理。

【逾期違約金】

二十八、依台糖公司規定辦理。

【完成使用保證金不予退還之事由】

二十九、申請人有下列情形之一者，其原繳完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金：

（一）違反本要點第十七點規定者。

（二）違反本要點第十九點規定者。

（三）未完成使用前，因可歸責申請人之事由，經本府終止土地出租契約者。

三十、　申請人因違反本手冊或相關規定致本府受有損害時，本府除得將完成使用保證金沒入外，申請人並應賠償本府所受之一切損害。

【土地出租契約簽訂、終止及違約責任】

三十一、為明確申請人與本府土地使用相關權利義務關係，承租人應於繳交完成使用保證金後，於1個月(或本府經發局通知期限)內完成土地使用契約之簽訂；申請人逾期或無故未依規定簽訂契約者，視為放棄申請資格，沒入原繳申租保證金，其餘價款無息退還。

三十二、申請人於如有下列情事之一者，經本府經發局通知限期改善，屆期未改善者，本府得終止土地使用契約並請台糖公司解除地上權契約，後限期申請人將土地回復原狀：

（一）違反本要點、土地使用契約或其附件規定者。

（二）以承租土地供違反法令之使用者。

（三）未依規定完成使用者。

（四）未經本府與台糖公司同意，承租土地上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記未以申請人為名義者。

（五）未經本府與台糖公司同意，申請人將土地、建築物及設施之全部或一部移轉、出租、出借或以其他方式供他人使用。

（六）未依法繳交產業創新條例第53條之各項維護費或使用費者。

（七）違反土壤及地下水污染整治法或相關環保法令，致土地遭污染者。

三十三、申請人如欲提前終止本契約，應於終止契約日前3個月前以書面通知本府經發局及台糖公司。

三十四、申請人如因違反本要點或其他規定致本府受有損害時，應依法賠償本府所受之一切損害。

【地上權契約簽訂及土地點交】

三十五、申請人於土地使用契約簽訂後3個月內，應洽台糖公司完成地上權契約之簽訂及土地點交作業。

三十六、申租土地自點交之日起，其所受之利益及危險，均歸屬申請人負擔，不因尚未簽約或取得土地使用權同意書而受影響，申請人對其承租之土地應負責維護管理，並須盡善良管理人之注意義務。

三十七、申請人於點交土地時應對公共設施尚未完成之情形充分了解，並同意日後不得就此等情形要求補償或拒絕繳款或點交。

【地上物之處理】

三十八、契約終止時，除與本府經發局及台糖公司另有約定外，申請人應於契約終止日或租期屆滿日返還土地，並應回復土地原狀。如逾期未回復土地原狀，本府得訴請法院強制執行，並由本府代為回復，該回復原

狀所需之費用（包括但不限於拆遷費、搬運費、廢棄物清運費、工資、管理費等），均由申請人負擔。

三十九、契約終止前，申請人可向本府經發局及台糖公司申請協商，將地上物無償移轉登記予台糖公司，或可依個案情況輔導申請人與其他廠商進行有償或無償處分地上物所有權，以活化承租土地之利用。申請人經輔導仍無法活化土地利用者，應於本府經發局限定期限內回復土地原狀。

【轉讓、合併及其他之限制】

四十、　在契約之有效期間，申請人不得將本契約轉讓、贈與、分割或為其他方式之處分。但經本府經發局與台糖公司書面同意者，不在此限。

【面積結算】

四十一、申租土地實際面積以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準，如有誤差應就超過或不足部份按原出租價格相互找補土地租金。

四十二、申請人於土地點交後，如因地政機關地籍圖重測或複丈致面積變更者，應按地政法規相關規定辦理。

【興建須知】

四十三、申請人使用承租土地，所需用水量、廢(污)水排放量、用電量、污染物總量及危害性化學物質應確實依本府審查決議事項辦理，本園區排放污染物單位面積核配基準參見本要點附件 3-2(申請人於建廠前如「仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定有變更，悉依最新規定辦理)，危害性化學物質清單參見本要點附件 3-5，申請人應自行比對有無使用危害性化學物質。

四十四、申請人構築建物、設立工廠，應依照建築法、環保法規、本園區都市計畫書圖、本園區土地使用分區管制要點、本園區污水下水道管理辦法、本園區建築景觀預審規範、本園區產業用地(一)容積總量管制執行要點、工廠管理輔導法及其他相關法規辦理，並應以申請人之名義為起造人。申請人依「仁武產業園區產業用地(一)容積總量管制執行要點」申請增加建築容積率者，應依規定繳納容積增量回饋代金。前開規定如有變更，悉依最新規定辦理。

四十五、申請人若在高雄市原已有設廠且需申請空污排放許可者，應優先於舊廠自行減量。

四十六、申請人須提出污染物排放量(參見本出租手冊「拾壹、仁武產業園區產業用地(一)用地申租書件」四、污染防治說明書)向本府申請，若超出

本園區排放污染物核配基準時，於符合「仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定時，超出之污染量應專案向本府申請調撥污染物排放量並應經本府審查同意。申請人應於調撥期間繳納環境回饋金，環境回饋金依「仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則」規定計算，申請人需簽訂調撥及減量切結書，後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率。前述污染物調撥量為暫時撥借，並非可無限期進行調撥，未來如區內廠商或後續入區廠商有需求，應無條件歸還或配合調整調撥量，故申請人應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。

四十七、申請人須提出危害性化學物質運作種類及數量(後續出租手冊「拾壹、仁武產業園區產業用地（一）用地申租書件」四、污染防治說明書)向本府申請，以統計是否符合本園區環評承諾運作量，若超出危害性化學物質管制種類及總量，需辦理環境影響評估變更後始得進駐。後續若因製程或原料改變，而導致原申請危害性化學物質運作種類及數量增加時，需向本府申請，並辦理環境影響評估變更經環保主管機關審查通過始得增加。若因申請人因素而需辦理環境影響評估變更時，申請人應自行付費辦理。

四十八、申請人於施工前應提出營建工程逕流廢水污染削減計畫書，以及空氣污染防制計畫書(含污染防治設施經費)，送當地環保局同意後，始得開工。空氣污染防制計畫書內容應具體、量化，可供查核，項目應包含：工程基本資料、環境座落及場內設施平面配置圖說、施工期程圖說、砂石土方產生量、空氣污染物排放源及排放量、各施工項目依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行之防制設施(另增加監控設施)內容，包括設施種類、效能、流程、使用狀況及其設計圖說。

四十九、申請人應將本府提供之「施工環境保護執行計畫」納入與承包商契約及施工規範，明訂工地環保作業要點及罰則，並要求承包商據以提出「工地環境保護工作執行計畫」並據以執行。

五十、　申請人應依本府研定之交通維持原則，納入工程合約中，責成承包商依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」，依本府相關規定送審。

五十一、申請人在取得土地使用同意書前，不得擅自開挖土方、傾倒廢棄土或構築工事，倘因而發生損害時，應負賠償責任。

五十二、營建剩餘土石方之處理，以於本園區土地內就地整平為原則。

申請人如需開挖土方，應以主管機關核定之計畫所需辦理工程為限。申租坵塊之土方應經台糖公司書面同意後，申請人始得外運，並應送至合法土資場處理，所需費用應由申請人負擔。

申請人如需加填土方時，應經台糖公司書面同意，除不得以建築廢棄土、爐石填土外，所填土方應為無污染及符合內政部營建署土質代碼表所列 B1、B2-1、B2-2、B2-3、B3 及 B4 等 6 類之土方或天然級配，且申請人應會同台糖公司與政府核可之環境檢測機構採樣檢驗及出具報告認可，以及符合環保法令等相關規定後為之，所發生費用概由申請人負責。

五十三、申請人並應自行採購裝設污水水質監測設施，並預埋管線且架設主機讀取相關數值。

五十四、申請人應承諾產業用水回收率 58%，並應考量可承擔之缺水風險後，自行設置 1 日以上用水量之蓄水設施；若用水量大於 600 CMD 者，應自行設置滿足 3 日以上用水量之蓄水設施。

五十五、本園區建築物主結構應以鋼筋混凝土或鋼架等耐火材料為主，建築物及基地出入口不得阻礙或破壞現有排水系統，且避免對道路交叉口截角開設，以維持交通安全。

五十六、申請人整地或構築建物期間應依據相關法規設置臨時滯洪沉砂池，妥為儲滯施工中之地面逕流水，避免基地土壤沖刷流失。

五十七、申請人整地或構築建物應自行設置排水系統將廠區之排水導入排水溝內，不得漫流，以免危害土坡或構造物之安全。

五十八、雨污水收集系統應採分流設計，不得將污水排入雨水系統中或將雨水排入污水系統中，另應加強廢水回收再利用，並納入申請書附件之用水計畫內容。

五十九、本園區內各項公共設施不得加以破壞，違者應負責修復或賠償。

六十、　申請人如需變更既有公共設施者，應先提出施工計畫書送經本園區服務中心核可後始得施工，相關設施遷移及復原所需費用，由申請人自行負責。

六十一、申請人構築建築物時，若毀損已完工之公共設施，申請人於修復並經本府或本園區服務中心確認無誤後，始得請領使用執照。

六十二、申請人構築建物時，若需埋設基樁，為避免損及鄰近地下及地上結構物，應注意適當之安全距離並遵守相關法規規定，以避免造成施工公害；倘因而發生損害或公害時，應負賠償或修復責任。

六十三、申請人使用本園區土地所產生之廢(污)水應依下水道法、本園區下水道管理辦法及本園區污水處理廠營運管理要點等規定，申請納入本園

區廢(污)水下水道系統處理，並於連接園區下水道系統前，完成廢污水採樣井、水質監測設施、流量計及制水閥之設置；其排放水質應符合本園區公告之污水處理納管水質限值後始得排入。若排放水質超過納管水質限值，應自行於廠內規劃設置污水處理設施，進行廢污水納管前處理。惟於本園區污水處理廠完工前，申請人所產生之廢(污)水由本府另行設置污水應急處理設施處理，相關費率及繳費方式由本府另行公告。

六十四、申請人使用承租/購土地所產生之廢(污)水，申請納入本園區污水處理廠處理時，應依本府核定之污水處理系統使用費率，按月繳交污水處理系統使用費；倘其排放之廢(污)水量大於規定標準者，其超過原規劃設置標準之廢(污)水排放量，另依該費率分級徵收之。

六十五、申請人排放之廢(污)水量如超過原規劃設置之污水管線容許量時，應自行評估設置專用污水排放管線銜接至污水處理廠，並提出施工計畫送經本府核可後施作，所需各項費用自行負擔。

六十六、申請人應依其生產方式及用電需求，逕洽台灣電力公司申請供電，或自行設置發電或汽電共生設備，並依台灣電力公司規定及供電系統所需，提供場地供裝設開關箱／變電箱之用。

六十七、申請人不得在公共道路上裝卸貨物、堆置物品、棄置廢棄物及停放車輛等，以維護交通安全。

六十八、申請人於構築建物、設立工廠，於進行整地、地下基礎開挖等工事前，應行文報知本府；倘因而違反「環境影響評估法」、「高雄市仁武產業園區環境影響說明書（定稿本及送環保署審查同意之變更書件）」及相關環保規定，應負連帶賠償責任，並依相關規定辦理。

六十九、申請人於施工建築期間，應遵守本園區之安全衛生管理辦法，以落實開發區之人員、車輛及機具管控，確保園區內之施工安全。

七十、　申請人如為行政院環境保護署依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，應於設立、停業、歇業或移轉土地所有權時，應依土壤及地下水污染整治法第 8 條及第 9 條規定自行辦理土壤污染檢測作業並提供本府乙份，所需費用自行負擔。

七十一、前點污染檢測資料，應同時檢送本園區服務中心 1 份，並應包括下列事項：

（一）事業基本資料：事業名稱及負責人、統一編號、地址、地號、土地使用類別、廠區配置圖、土地使用人、管理人或所有人及聯絡方式等。

（二）事業運作情形：生產製程、使用原料、產品、污染來源、污染物種類與成分、處理情形及相關污染防治措施。

（三）檢測及分析結果：檢測項目、採樣檢測方法、檢測數量及品保品管等。
（四）檢測機構：機構名稱、地址及許可文件影本。
（五）其他經主管機關指定之資料。

七十二、倘因申請人使用申租土地，致該土地遭公告為土壤污染控制場址時，申請人應依法提出污染控制計畫，並採取污染防治措施，以避免污染之擴大並儘速使申租土地解除土壤污染管制區劃定。至倘因相關環保法規之污染整治管制措施致本府受有損害，申請人應賠償本府所受之一切損害。

七十三、申請人如為環境部依土壤及地下水污染整治法指定公告之事業，或本府經發局認為有必要時，應於租賃契約解除交還申租土地時，提供土壤污染檢測資料予本府，如未檢具前開土壤污染檢測資料而欲解除契約，應於租賃契約解除之日起2個月補正之。逾2個月仍未補正者，本府得委請第3人檢測，並向申請人請求相關費用。

七十四、申請人未來建廠時應將土壤液化與不均勻沉陷等問題列入設計考量，並應依建築技術規則等相關法令規定辦理。

七十五、本園區土地(含產業用地退縮帶)內如有地下管線、地面人(手)孔、雨污水收集、邊坡擋土等公共(用)設施(備)之相關需求，申請人不得異議；其地面除作空地、綠地及通道外，不得構築建築物或加以破壞，本園區服務中心並得派員進入清理維護該等公共設施(備)、辦理污水採樣等作業，申請人不得拒絕。

七十六、申請人使用各項公共管線，除接戶線部分需自行洽各該事業主管機關辦理外，必要時並應無條件提供鄰地使用人共同使用接點。

七十七、申請人應依產業創新條例第五十三條規定繳交下列各項維護費或使用費：
（一）一般公共設施維護費。
（二）污水處理系統使用費。
（三）其他特定設施之使用費或維護費。

七十八、申請人應依本園區環評書件所載之內容及審查結論切實執行，若有違反情事，致本府遭受主管機關裁罰，本府將追究申請人責任並求償。

七十九、配合現行環保法令或新公告法令規定，本府若需於承租/購土地設置環境監測設施，申請人應需配合本府要求不得拒絕。

八十、　其他法規另有規定者，申請人亦應遵守，不得違反之，否則即屬違反契約。

【其他】

八十一、本要點規範之園區服務中心權責，於本園區服務中心成立前，由本府經發局統籌辦理；本要點規範之開源公司權責，於本府與開源公司契約屆期後，由本府經發局統籌辦理。

八十二、本府有增加、調整、變動或修改本要點內容之權利，如有其他未盡事宜，應依相關法令釋疑之。

附件 3-1　仁武產業園區產業用地容許引進產業類別

產業用地(一)係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：

一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：

（一）金屬製品製造業（不含金屬表面處理業）

（二）機械設備製造業。

（三）電力設備及配備製造業（不含放射性工業、電池製造業與專門表面處理之行業）。

（四）汽車及其零件製造業。

（五）其他運輸工具及其零件製造業。

（六）電腦、電子產品及光學製品製造業。

（七）食品及飼品製造業。

（八）塑膠製品製造業。

（九）家具製造業。

（十）經本府工業主管機關核定之低污染製造業(參考經濟部負面表列低污染製造業認定基準，詳下表)。

二、與工業生產相關之行業，包括以下：

（一）電力及燃氣供應業。

（二）批發業（不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業）。

（三）倉儲業（含儲配運輸物流）。

（四）資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。

（五）企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

（六）污染整治業。

（七）洗衣業（具中央工廠性質）。

（八）經本府工業主管機關核准安置之既有行業。

註：放射性工業(包括放射性元素分裝、製造、處理工業，及原子能工業)、電池製造業與專門從事表面處理之行業，不得進駐本產業園區。

產業用地（二）係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

一、住宿及餐飲業。

二、金融及保險業。

三、機電、管道及其他建築設備安裝業。

四、汽車客、貨運業、運輸補助業、郵政及快遞業。

五、電信業。

六、第四點第一項以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。

七、其他教育服務業。

八、醫療保健服務業。

九、創作及藝術表演業。

十、連鎖便利商店。

十一、其他經中央主管機關核准之行業。

第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

低污染認定基準

本認定基準採負面表列方式，凡不在下表所列舉之行業別或製程者，屬低污染事業。

編號	細類	非屬低污染行業別或製程
1	0896010	味精(麩胺酸鈉)(從事不具醱酵生產製程事業者除外。)
2	0896020	高級味精(從事不具醱酵生產製程事業者除外。)
3	0896090	其他胺基酸(從事不具醱酵生產製程事業者除外。)
4	0899210	酵母粉(含健素類)(僅從事摻配事業者除外。)
5	1140	染整業(從事無水加工、定型、刷毛、剪毛、壓光、塗佈、貼合等除外。)
6	1301	皮革及毛皮整製業
7	1401	製材業(僅以製程包含木材乾燥、浸漬防腐等保存處理之事業為限。)
8	1511	紙漿製造業
9	1700	石油及煤製品製造業(屬簡單加工之物理性製程，無化學反應者除外。)
10	1810	化學原材料製造業
11	1830	肥料及氮化物製造業(從事以非化學方法、非發酵腐熟方式製造之摻配者除外。)
12	1841	塑膠原料製造業(屬混合(compound)製程、押出造粒製程者除外。)
13	1842	合成橡膠原料製造業(屬混合(compound)製程、押出造粒製程者除外。)
14	1850	人造纖維製造業(從事酯粒抽絲生產之製程除外。)
15	1910	農藥及環境用藥製造業(從事 1910045 生物性農藥之製造加工者除外。)
16	1920	塗料、染料及顏料製造業
17	1990	未分類其他化學製品製造業(屬硬脂酸鹽安定劑製造業（含鎘、汞、鉛、砷、鉻、鎳重金屬），以融溶法製造者除外。)
18	1990110	炸藥、煙火、火柴
19	2001	原料藥製造業
20	2101	輪胎製造業
21	2311010	平板玻璃(僅就玻璃以電熱爐加熱及吹風降溫，或從事玻璃切割、雕花或組裝事業除外。)
22	2311110	強化玻璃(僅就玻璃以電熱爐加熱及吹風降溫，或從事玻璃切割、雕花或組裝事業除外。)
23	2313	玻璃纖維製造業(從事玻璃纖維切割組裝事業除外。)
24	2322	黏土建築材料製造業
25	2331	水泥製造業
26	2332	預拌混凝土製造業

27	2333	水泥及混凝土製品製造業(高壓混凝土磚、預力混凝土管、纖維水泥板及矽酸鈣板事業除外。)
28	2399	未分類其他非金屬礦物製品製造業(僅限從事砂石碎解加工業者，但依法設置有廢水處理設施者除外。)
29	2399210	石綿水泥瓦
30	2399290	其他石綿製品
31	2399940	瀝青混擬土
32	2411	鋼鐵冶鍊業
33	2412	鋼鐵鑄造業
34	2421	鍊鋁業
35	2422	鋁鑄造業
36	2431	鍊銅業
37	2432	銅鑄造業
38	2491	其他基本金屬鑄造業
39	2499	未分類其他基本金屬製造業(僅限鋅、鎘、鎳、鉛等金屬冶煉者。)
40	2543	金屬熱處理業 (一、非真空熱處理製程且符合下列3條件之一者除外：1.採用天然氣為熱源之熱處理爐，且燃料爐具備熱回收及廢氣處理再利用系統。2.加熱源為高效輻射、管式、噴流、板式器、熱管等熱交換器之熱處理設備。3.以水和空氣為淬火介質的非燃料熱源之熱處理設備。 二、真空熱處理製程具備真空熱處理設備者除外。)
41	2544	金屬表面處理業
42	2611	積體電路製造業
43	2612	分離式元件製造業
44	2620	被動電子元件製造業
45	2630	印刷電路板製造業
46	2641	液晶面板及其組件製造業
47	2649	其他光電材料及元件製造業
48	2691	印刷電路板組件製造業
49	2699210	工業用電子管(影像專用)
50	2820	電池製造業
51	2841	電燈泡及燈管製造業(從事LED照明燈泡、LED照明燈條等事業除外。)
52	非屬以上行業別，但製程含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理者。	
53	其他經直轄市、縣（市）主管機關審核增列者	

附件 3-2　仁武產業園區資源或污染物單位面積核配基準

產業類別		用水量(CMD/公頃)	污水量(CMD/公頃)	用電量(KW/公頃)	空氣污染物(公噸/年/公頃)				廢棄物(公噸/日/公頃)		
					粒狀污染物	氮氧化物	揮發性有機物	溫室氣體	一般廢棄物	一般事業廢棄物	有害事業廢棄物
08	食品及飼品製造業	**70**	56	864	0.6791	0.3589	1.0292	4,425	0.0445	0.2335	0.0150
22	塑膠製品製造業	**20**	16								
25	金屬製品製造業	**35**	28								
27	電腦、電子產品及光學製品製造業	**120**	96								
28	電力設備及配備製造業	**30**	24								
29	機械設備製造業	**40**	32								
30	汽車及其零件製造業	**50**	40								
31	其他運輸工具及其零件製造業	**50**	40								
32	家具製造業	**15**	12								
經本府工業主管機關核定之低污染製造業		**15**	12	691.2	0.5433	0.2871	0.8234	3,540	0.0356	0.1868	0.0120

註 1：園區產業用水回收率 58%。

註 2：園區用電量、溫室氣體(燃料)排放量高於平均值者需減量或提出溫室氣體減量計畫。

註 3：申請量超過核配基準者應填寫相關計畫並經申請調撥同意後始得進駐。

註 4：因事業廢棄物入區申請量為每年產生量，本園區係以每年 240 工作日計算每日產生量作為管制依據。

附件 3-3　仁武產業園區污水處理納管水質限值

水質項目	最大限值 (單位:mg/L)	水質項目	最大限值 (單位:mg/L)
水溫	45℃	鋅	5.0
pH 值	5~9	銀	0.5
懸浮固體	350	鎳	1.0
生化需氧量	200	硒	0.5
化學需氧量	450	砷	0.5
真色度	550	硼	1.0
氟化物	15.0	甲醛	3.0
硝酸鹽氮	100	多氯聯苯	0.00005
氨氮	50	總有機磷劑	0.5
酚類	1.0	總氨基甲酸鹽	0.5
陰離子界面活性劑	10.0	安特靈	0.0002
氰化物	1.0	靈丹	0.004
硫化物	1.0	飛佈達及其衍生物	0.001
油脂(正已烷抽出物)	10.0	滴滴涕及其衍生物	0.001
溶解性鐵	10.0	阿特靈、地特靈	0.003
溶解性錳	10.0	五氯酚及其鹽類	0.005
鎘	0.03	除草劑	1.0
鉛	1.0	安殺番	0.03
總鉻	2.0	毒殺芬	0.005
六價鉻	0.5	五氯硝苯	0.00005
總汞	0.005	福爾培	0.00025
甲基汞	0.0000002	四氯丹	0.00025
銅	3.0	蓋普丹	0.00025

註 1：水質限值除水溫為℃、pH 值及真色度無單位外，其餘為 mg/L。
註 2：本表數據僅供參考，應依本府公告之「高雄市仁武產業園區下水道管理辦法」規定之納管限值為準。

附件 3-4　仁武產業園區廠商建廠應遵循之環評承諾事項

壹、施工階段

一、地質與地形

- 基礎承載力呈現不足時，則應採用適合之地盤改良作地層改善或施作深基礎。
- 開挖整地裸露面鋪設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施(如帆布、防溢座)，降低暴雨沖蝕對地形與地質之影響，或以噴漿方式保護坡面。
- 地質方面，依據現有地質調查資料及預測分析結果，施工期間對地質的影響不大。因此就明挖工程而言，將藉由擋土、水土保持、截排水、邊坡穩定、植生綠化等措施，以保持地層的安定。
- 細設及施工時考量抽水時機與停止抽水時機，避免湧水、地下室上浮。施工時配合監測作業掌握鄰房與地表沉陷情形，視需求先進行鄰房保護措施。

二、空氣品質

- 選用低硫柴油(如低硫柴油、柴油應符合含硫量 50 ppm 以下規定等)之機具、車輛，並定期保養，限制老舊施工機具或設備之使用，可減低污染物之排放；施工機具使用之油品，將符合車用汽柴油成分及性能管制標準。
- 整地作業期間，對挖填面利用灑水車或佈置灑水設施，視工區情況加以灑水，晴天時進行適當灑水，每日約 2 次，尤其是在風速較大之時，增加灑水頻率，以減少粒狀物之飛揚。
- 運輸卡車將加以清洗輪胎及車輛表面等，避免將工區泥砂攜出。
- 運輸卡車所載物料若為易飛散者，則加蓋帆布或防塵罩，防止不當之逸漏發生。
- 本營建工地將依環保署公告之「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」及「逸散性揚塵管制相關法規（營建工地）」確實處理。
- 將要求營建商依「高雄市逸散性污染源及營運工程稽查管制暨空氣防制費徵收減免查核計畫」所列各項防制設施；須使用複合性的防制措施，使防制效率達 80%以上。
- 由於施工工地揚起之粒狀污染物與施工面積成正比，故將採分段施工，減少同一時間排放源面積，同時裸露面積不超過 3.5 公頃，整地完成之地面隨即覆蓋或植生。

三、噪音振動

- 妥善規劃施工運輸動線，行經人口密集之社區將減速慢行，避免對當地居民造成影響。
- 於工區周邊設置密接式施工圍籬，以降低工區施工機具噪音。
- 施工機具及運輸車輛定期進行保養檢修，工區限制不必要之機具空轉或車輛於工區內任意行駛，以減少噪音產生來源。
- 做好敦親睦鄰及事前說明工作，若接到居民之陳情抱怨，將即時處理並配合調整施工方式以降低噪音及振動影響。

- 施工運輸車輛避免超載及密集集中施工，行駛時避免猛然加油或高速行駛，以降低噪音振動產生量。
- 施工期間針對工區附近敏感點進行噪音及振動監測，以供後續環保措施調整之參考。

四、河川水文水質

- 施工前依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 10 條規定，於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫報主管機關核准並據以實施。
- 施工前依「水污染防治法」第 13 條規定，於設立或變更前，應先檢具水污染防治措施計畫及相關文件，送直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關審查核准。營運前依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 4 條規定，水污染防治措施應經主管機關核准。
- 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 49-3 條規定，營建工地施工期間，於其周圍排水溝排放管線底部、進入水體處及其周圍環境，形成可見之沉積污泥時，營建業主應予以清除，或依主管機關之命令，於 3 天內清除。施工機具、車輛維修、保養所棄置或溢洩之廢機油、潤滑油、柴油等，營建業主應以適當之儲存設備收集處理，不得隨廢（污）水或逕流廢水排放或溢流於作業環境外。
- 依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 68 條規定，作業環境之剩餘廢（污）水應由該事業負責人，依規定處理及排放。
- 將依據「降雨逕流非點源污染最佳管理技術指引」，於設計階段將降雨逕流污染控制設施納入考量，使開發完成之地區於降雨時所產生之降雨逕流污染獲得控制，以削減非點源污染排放量。
- 依「施工活動非點源污染最佳管理措施」規範，於開挖面或堆置場所，舖設足以防止雨水進入之遮雨、擋雨及導雨設施(如帆布、防溢座)；並採用臨時性截、排水及沉砂設施，以收集初期降雨所產生之降雨逕流，削減非點源污染排放量。
- 工區四周設置全阻隔式圍籬及防溢座，阻絕區內逕流漫流區外，避免對周邊排水造成影響。
- 優先施作臨時性排水溝及臨時滯洪沉砂池，並以基地內既有之排水系統配合臨時性排水溝截取地表逕流水，以確保施工區內之逕流水及泥砂進入臨時性滯洪沉砂池內及可順利臨接聯外排水系統。
- 將要求承包商應依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第 9 條規定，做好營建工地開挖面或堆置場所之擋雨、遮雨、導雨、沉砂池設施及定期清理維護工作。辦公場所、員工宿舍產生之生活污水，應妥善收集處理。
- 於工區內設置簡易式廁所供施工人員使用，並委託合格代清除業者清運處置，避免對鄰近承受水體造成影響。
- 妥善收集施工機具維護保養衍生之廢油，避免其滴落地面污染鄰近水體。

- 定期清除區內截、排水及沉砂設施內雜物及淤砂，確保其功能正常。
- 施工機具因施工、維修及放置所產生之油污，將責成工程包商嚴格管理，包括定點抽換機油、潤滑油，於工程合約中要求承包商對所有廢機油等定點集中收集，並將廢油置於收集桶中，避免外洩，視收集數量不定期委託合格代清除處理業者清除處理處置。
- 在洗車廢水部分，規劃於洗車台旁設置收集槽，其廢水於槽內沉澱泥砂後，將重複利用或用於工區灑水。

五、廢棄物

- 承包商產生之一般垃圾須妥善收集，並委託清潔隊或合格公民營廢棄物清除處理機構代處理，並依廢棄物清理法相關規定辦理廢棄物清除處理作業，不得棄置或露天燃燒。
- 針對施工作業產出之事業廢棄物，包商應分類收集並委託合格廠商依法令規定進行清運、處理工作。
- 承包商應要求廢棄物清運車輛之車斗須設有覆蓋措施，以免清運路途中有廢棄物散落情形發生。另廢棄物清運車輛之車體不得有滲漏之情形，且出場前須沖洗清潔，保持車體及車輪乾淨。
- 若未來園區進駐廠商製程中需使用毒性化學物質為原料，將要求廠商需依據毒性化學物質管理法辦理。

六、溫室氣體

- 施工規劃時，須讓使用之機具最少化，而效率最大化，並且盡量避免不必要之機具閒置或使用，以減少施工時之溫室氣體排放。
- 避免不必要或過度長時間之人力使用及閒置，造成施工時，園區中因多餘人為活動而造成設備電力(外購電力)之溫室氣體排放。
- 施工期間園區中之留宿區，其照明及相關設備應用有節能認證之設備，或設置自動感應及斷電系統，減少不必要之電力浪費。

七、生態

- 植物提供動物棲息場所，而葉子、果實、花蜜為提供動物食物來源，故植物保存的程度直接與動物生存相關，切勿開挖開發預定地外圍植被，以維繫生物棲息地。為保護剩餘植群，除了避免工程機具進入計畫範圍外之林地破壞，更應向人員宣導勿入內攀折樹木。
- 植物提供動物棲息場所，而葉子、果實、花蜜為提供動物食物來源，故植物保存的程度直接與動物生存相關，切勿開挖開發預定地外圍植被，以維繫生物棲息地。為保護剩餘植群，除了避免工程機具進入計畫範圍外之林地破壞，更應向人員宣導勿入內攀折樹木。
- 施工階段車輛出入沿線加強灑水工作，用加壓水柱噴灑工程地點及施工車輛出入沿線之樹木植被，以改善環境品質與植被健康。
- 工程開挖後裸土及裸地應敷蓋，並加強撒水，降低落塵影響。
- 漸進式進行開發避免大型機具施作造成巨大噪音及震動影響。

- 施工範圍應設立圍籬以防止動物誤闖入工區而受傷，並可降低工程機具噪音的干擾，此外，圍籬應確實架設，避免於地表活動的生物透過地下掘穴的方式越過圍籬進入工區。
- 減少夜間燈光照明，減少干擾夜行性動物。
- 應避免夜間施工以降低對夜習性動物(如雨傘節)影響。
- 嚴格禁止施工人員騷擾及獵捕野生動物。
- 施工過程中，地表開挖或整地、大型機具的操作及廢棄土方處置，皆須採取適當防護措施，避免地表逕流或雨水將廢棄土方及大型機具操作後所遺留下的廢棄油污沖刷進入承受水體，污染水域生態環境。
- 施工中生活污水應妥善處理，禁止隨意排放於鄰近水體，避免污染水域生態。

八、社會經濟

- 施工期間需要大量之工作人員，人員之雇用以當地居民為優先，一方面增加當地之就業機會，另一方面降低成本，合乎經濟效益。
- 施工所需之材料、機具，優先尋求當地廠商提供，以增加當地經濟活動，增加政府之稅收。
- 施工期間除了優先雇用當地居民外，對外來之工作人員，可在基地規劃適當地點，集中食宿管理、生活作息訂定規範，以減少對當地之社會環境之影響。
- 加強工地管理，設置安全警示標誌，隨時提醒當地居民注意安全，另一方面也保護施工人員之安全。

九、交通運輸

- 減少施工路段及區域通過車輛，施工期間由於道路容量縮減，必須引導車流行經其它道路，以避免施工區域道路交通過度飽和。
- 加強施工區域、工程範圍、施工期程、替代動線等資訊之宣導，讓所有可能通過施工區域之用路者能充分掌握交通狀況，並能事先行前規劃其行駛動線，進而減少工區附近之交通量。
- 施工階段之工程車輛避開平常日之上、下午通勤尖峰時段進出。
- 減少施工佔用道路面積及時間，在工程經費、施工佔用道路面積最小化與時間最短化間取得平衡，以減少施工佔用道路面積與時間。
- 擴充施工路段之道路容量，對施工期間用地遭佔用之路段應調整其道路利用方式，擴充可供人、車通行之空間，降低施工路段道路容量之減少。
- 為減少施工運輸車輛對當地之交通造成不利影響，對於行經計畫區週邊道路車輛將採適當之管制措施如下：
  - 機動調整運輸時間，避免交通尖峰時刻行駛以減輕影響程度，另對於狹小彎曲路段將設置警示標誌，以維護交通安全。
  - 於各重要路口，如施工區出入口及鄰近社區附近，視實際行車情形，機動調派人員

指揮交通，以免交通阻塞，維護交通安全

- 運輸車輛進出路線規劃使用距離工區最近之快速道路為主要動線，使鄰近之環境及交通影響減至最低。另運輸車輛將要求做好裝載防護措施，避免材料掉落對道路環境及交通車流產生衝擊。

十、景觀及遊憩

- 避開遊憩交通尖峰時段，連續假日及上下班上午 8 至 10 時及下午 4 至 6 時，為鄰近遊憩交通較頻繁之時段，大型施工車輛及砂石卡車除非必要，將避開於該時段進出。
- 重機設備進出工地，避開遊憩活動尖峰期或假日。非不得已執行施工交通管制時，事先規劃引導標示替代道路。施工場所與交通幹道出入口，增設臨時轉彎迴車空間及指示牌號誌，每逢遊憩活動產生之交通尖峰時刻，由施工單位派員協助疏導交通車流。
- 鄰近主要遊憩動線道路或其他道路之路面，若因施工車輛與機具搬運所造成之毀損，應隨時補強修復，以免影響遊客自用車輛或遊覽車之行駛。
- 施工期間，路面應注意道路揚塵的灑水，降低對鄰近遊憩據點品質的影響，減輕過往遊客的不愉快體驗。

十一、文化環境

- 施工前針對計畫基地內進行鑽探工作，以確認地層堆積與文化層埋藏的狀態，調查計畫內容請詳附錄 18，如發現有疑似遺址或其他類型文化資產的出現，則依《文化資產保存法》之相關規定辦理，以減輕文化資產的損失。
- 本計畫於工程進行整地、開挖期間委請具考古專業之學者進行施工監看或文化資產調查，若發現有文化遺址之出土，則依「文化資產保存法」相關規定處理。
- 未來開發過程中，如發現任何涉文化資產標的，將依〈文化資產保存法〉第 33、57、77、88 條規定辦理，並注意工程是否涉及民俗活動場域。

貳、營運期間

一、地質與地形

- 營運階段由廠商依照分區類別及需求進行建物興建，屆時須依相關法令規定(如：建築技術規則、營建工程空氣污染防制設施管理辦法、逕流廢水污染削減計畫…等)執行相關保護措施，預期對環境之影響應屬輕微。

二、空氣品質

- 配合相關空氣污染防制法令，輔導進駐廠家提出空污排放許可申請，並確實執行許可之內容（包括操作方法及設備維護等）。
- 由園區管理單位進行排放總量核配管理，並登錄各廠家核配量，要求各廠家控制其排放上限。
- 進駐廠商排放量達一定規模者須依行政院環境保護署公告各行業之最佳可行控制技術進

行污染防治，配合進行控制技術之改善。

- 要求各進駐廠商依其污染物排放特性設置空氣污染防制設備，做好工廠廢氣排放之防制措施，確保所排放空氣污染物濃度符合相關法規限值，並進行維修保養及人員操作訓練。
- 定期查核園區廠商污染排放，督促各廠家加強污染防制措施。要求廠商設置必要之污染防制設備，符合環保署公告之「固定污染源空氣污染物排放標準」相關規定。
- 全力配合地方環保單位執行稽查工作並參加相關環保課程，以明瞭最新之相關法令及措施。
- 於廠區內實施綠化植栽工程，以減少空氣污染物對環境的影響。
- 園區員工可搭乘交通車，以減少聯外道路車輛排放廢氣。
- 本園區承諾營運期間要求廠商之鍋爐必須使用天然氣替代燃油做為燃料或使用電力，並優先引進低污染產業，鼓勵業者採用低污染製程。
- 將依開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第 49 條第 2 項規定，定期向地方主管機關申報污染總量核配情形。
- 本計畫將依環保署所定「街道揚塵洗掃作業執行手冊」內容辦理街道清洗作業。

三、惡臭

- 針對污水處理廠確實做好二次污染防治措施（如易產生之臭味操作場所與設備予以密閉加蓋），以使臭味產生降至最低，不會產生惡臭逸散至空氣當中而對週遭環境造成影響。

四、水文水質

- 本園區之工業廢水係各工廠工業廢水符合園區規定之專用下水道納管限值後，排入廢水收集管線送至污水處理廠處理，經本園區污水處理廠處理後之廢水以專管搭排仁大海放管海放。若工廠原始廢水之污染物濃度不符納管標準，工廠須先自行進行前處理，以避免過高污染物濃度流入園區污水處理廠。
- 本園區營運階段將訂定相關管理要點，要求各用戶設置水量、水質監測設施，並整理統計資料備查；污水處理廠亦將設置水量、水質監測設施，並訂定期採樣檢測之水質項目，俾管控進流水量及水質，發揮污染預警功能，爭取黃金稽查時間。
- 除設置監測設備，園區管理單位將訂定檢驗頻率、實際採樣檢測，並加強夜間及假日稽查，此外，將要求污水處理廠之代為操作維護廠商針對違規排放廢(污)水進入污水下水道系統或影響污水廠進流水質等行為進行稽查及查報作業。
- 此外本計畫之節約用水措施規劃如下：
  - 雨水貯留：依「建築物雨水貯留利用設計技術規範」及綠建築之相關規定，鼓勵廠商設置雨水貯留設施，將雨水收集及簡易處理後，作為雜用水之補充水源。
  - 使用省水器材：鼓勵園區內之建築物及廠房採用省水器材，以增益節水成效。
  - 工業用水回收再利用方式：
  - 工業用水再利用：回收利用、循環利用與逐級利用等

- 可回收項目：冷卻循環水、鍋爐蒸汽冷凝回用水、製程回用水與逐級利用回用水等。

五、廢棄物

- 區內各廠商應針對一般廢棄物妥適進行資源回收工作，分成一般垃圾及資源回收物(包括廚餘類、巨大垃圾及資源垃圾)，以減少待清除處理之一般廢棄物數量。
- 區內各廠商須針對其產出之廢棄物，依廢棄物種類分別收集並分開貯存，其中一般事業廢棄物及有害事業廢棄物之貯存設施設置須符合現行相關環保法令(如事業廢棄物貯存清除方法及設施標準)之規定。
- 有關一般廢棄物清除處理，可委託合格公民營清除處理機構清運至高雄市四座一般廢棄物垃圾焚化廠(包括中區、南區、仁武及岡山等 4 座焚化廠)進行焚化處理或其他合法處理廠處理，基於低碳清運原則優先清運至仁武焚化廠處理。
- 有關事業廢棄物清除處理，區內各廠商園區須依其產生之廢棄物類別及特性，並按現行相關法令規定，自行辦理網路申報作業及委託合格之公民營清除處理機構進行清除處理，其中與一般垃圾性質相似之一般事業廢棄物亦可委託大型垃圾焚化廠處理，特殊(有害)事業廢棄物則可清運至有害事業廢棄物處理廠，例如經濟部工業局於大發工業區輔導設置之「榮民工程股份有限公司大發事業廢棄物處理廠」進行處理。
- 各廠商依廢棄物清理法第 31 條規定，應透過網際網路向所在地環保局申報廢棄物產生量(包括再利用量)與清理流向。
- 本園區管理單位將配合本府環保局查核廢棄物申報情形進行稽查管制，查核工作包括日間查核作業及機動巡查作業。
- 不定期查核並針對 GPS 清運軌跡資料及事業廢棄物申報資料與許可文件交叉比對，經查核發現不符者，即請事業單位進行改善並提送相關申請文件辦理變更；違規情事重大者，本園區管理單位將另行發文報請環保主管機關予以處置。
- 本園區規劃引進之產業類型係以金屬製品製造業、機械設備製造業、電子產光學製品製造業、汽車及其零件、其他運輸工具及其零件製造業等為主，比對行政院環境保護署事業廢棄物申報及管理資訊系統(IW&MS)登載之製程對應原物料、產品及廢棄物對應關聯表，本園區主要產業之原料鮮少使用毒性化學物質做為原料。若未來園區進駐廠商製程中需使用毒性化學物質為原料，將要求廠商需依據毒性化學物質管理法辦理。
- 廠商申請進駐本園區時應提交污染防治說明書，羅列可能使用之化學品及運作量；本園區管理單位將檢覈是否符合「健康風險評估技術規範」第 12 點規定之「無關聯」認定原則，若超過解釋令所列之運作量，即不得入園。
- 進駐廠商完成建廠、正式營運前，需依仁武產業園區化學物質管制作業要點，向園區管理單位申請核發註冊碼，於園區化學品資訊系統填入使用資訊，並持續更新化學品運作量。
- 園區管理單位將依危害性化學品標示及通識規則輔導園區廠商儲貯及處置，並勾稽比對

廠商使用之化學品品項及運作量是否有超出污染防治書所列情形。

- 依照化學品登錄資料，不定期安排專家或派員進廠進行現場稽核，藉此確認各廠商化學物質登錄、使用情形。

六、溫室氣體

- 環保署於107年8月13日預告「溫室氣體抵換專案管理辦法」修正草案，提供執行減量業者可取得碳權機制，未來將要求區內廠商配合最新公告法規辦理，並鼓勵小型排放源參與減量工作。
- 本園區將配合國家政策，藉由公有建築裝設太陽能光電、要求進駐廠商依「高雄市綠建築自治條例」設置太陽能光電發電設施、提升節能技術及廠商節能管理等方式，於西元2025年提升再生能源利用率至20%。
- 輔導進駐廠商之廠房針對照明、採光、用電系統採省能設計，以降低能源消耗。
- 鼓勵園區機構、社團及個人參與綠地開發及維護，推動廠商參與綠地行道樹認養，提升碳匯。

七、生態

- 預定開發基地開發前棲地形態以人工林及荒廢草生地為主，鳥類組成以野鴿、珠頸斑鳩、家燕、洋燕、紅嘴黑鵯、綠繡眼、麻雀等數量較多，開發後人工建物進而取代人工林及荒廢草生地，因此鳥類組成可能轉變為適應人工建物物種為主，例如麻雀、白尾八哥等。未來園區內綠美化植物初步規劃優先以台灣原生物種為主，並搭配鳥餌誘鳥、蝴蝶食草、蜜源植物等具有生態意義及功能的植株，且以適地適種及多層次原則進行種植，營造及增加生物的棲息、利用與覓食的空間。本計畫之環境監測計畫亦已規劃陸域生態中鳥類監測，將持續掌握陸域動物的變動情形。

八、社會經濟

- 為有效控管土地利用效率，避免土地炒作，除委託本府出租營管者外，承購產業用地應於取得所有權之日起3年內依法完成使用(可自行建廠或出租予需地廠商)，不得閒置，且完成使用滿5年後始得轉售土地，違者，依產業創新條例第46-1條及其子法產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法規定，本府得公告為閒置土地、處以當期公告現值10%之罰鍰及公開強制拍賣。

九、景觀及遊憩

- 優先保留台灣原生種(楓香、台灣欒木、茄苳、烏臼、白千層、光臘樹)做為園區景觀綠化之用，再因地制宜選用種植適合高雄地區在地環境之樹種做整體景觀綠化配置。

參、總量管制事項

- 廠商進駐後需配合園區污染總量管制，管制總量及單位面積核配基準如附件3-2。
- 廠商須依空氣污染防制法第24條規定，依據固定污染源設置與操作許可證管理辦法提

送空氣污染防制計畫書予本府環保局審查，載明排放空氣污染物之種類、成分、濃度、排放量，及相關空氣污染防制方法等，若達總量管制規定之一定規模者，需取得抵換量後，方可取得操作許可證，始得進行固定污染源的試車及操作。

肆、未登記工廠進駐輔導與管理

- 未登記工廠篩選機制
  - 為能有效篩選進駐未登工廠，使其能符合本園區之進駐規定，將要求進駐廠商提具投資營運計畫書(含原料來源及性質說明、產品與技術、土地利用與建廠計畫、用水回收計畫、污染防治說明書…等)，經審核，為園區擬引進產業並符合相關環保要求及土地使用規範，方得進駐建廠。
  - 進駐廠商應簽署申租購土地承諾書，承諾承租購土地之建築開發與營運，同意依園區土地使用規範及環評書件所載內容及審查結論切實執行。
  - 此外，區外未登工廠進駐園區應簽署原土地限期回復農用切結書，未於期限(新廠建廠完成並遷入後6個月內)回復，將依相關法令查處。
- 未登記工廠進駐管理方式
  - 本園區係依產創條例整體規劃、開發、營運之產業園區，廠商進駐構築建物、設立工廠，應依照建築法、環保法規、園區都市計畫書圖、園區污水下水道系統管制要點、園區污水下水道排水設備裝置要點、工廠管理輔導法、產創條例及其他相關法規辦理；於本園區設有服務管理中心統籌園區營運管理業務下，未來若有違規使用情形，服務管理中心將依相關規定舉報查處。
  - 原違規工廠土地所有權屬廠商所有，於新廠建廠完成並遷入後6個月內將原違規工廠拆除、土地恢復農用，始准予同意於園區進行相關業務申請；若廠商未依承諾期限將原違規工廠拆除、土地恢復農用，將依農業發展條例、建築法、都市計畫法、工廠管理輔導法等相關法令查處。
  - 原違規工廠土地所有權非屬廠商所有，本府行文通知土地所有權人限期恢復農用，並依農業發展條例、建築法、都市計畫法、工廠管理輔導法等相關法令加強查處取締，避免轉租違法使用。

伍、其他應注意事項

- 基礎承載力呈現不足時，則應採用適合之地盤改良作地層改善或施作深基礎。
- 整體開發行為並無直接污染土壤之虞，營運後依據「土壤及地下水污染整治法」及「目的事業主管機關檢測土壤及地下水備查作業辦法」之規定，定期檢測土壤及地下水品質狀況，定期辦理申報、檢視。
- 本府公告招商時，將要求申租購土地廠商依園區規範提具投資營運計畫書(含原料來源及性質說明、用水回收計畫、污染防治說明書…等)並簽署申租購土地承諾書，承諾承

租購土地之建築開發與營運，依園區土地使用規範及環評書件所載內容及審查結論切實執行；營運階段，本府將透過定期稽核與輔導方式，要求進駐廠商及未登工廠確實執行，以落實環評承諾。

- 本計畫區施工期間之用水，包括區內設置之辦公營舍所需民生用水及施工所需用水，將洽自來水公司接設臨時用水，以供應區內車輛清洗、道路揚塵灑水及植生灌溉用。
- 施工用電擬向台電公司申請臨時用電，提供必要之民生電源。至於施工通訊，於辦公室以申請電話、網絡線路及傳真機等設施，提供對外聯絡網路；而在工區則將申請行動電話或無線對講機，以便於工地間及工地與辦公室間之聯繫。
- 本園區建築物應依高雄市綠建築自治條例規定辦理，並於建築物屋頂設置太陽光電發電設施。

附件 3-5　危害性化學物質清單

填報注意事項：

1.請提供正確使用物質之名稱(包括英文全名或化學式)

2.若單一原料內含有多項危害性化學物質需逐項填列,需填預計年使用重量(公噸/年)，勿填體積，若非純物質，請自行以百分比及比重換算

3.所使用物質及數量請填寫於申租文件附表七土地污染防治說明書之危害性化學物質申報書清冊欄位內。

4.依行政院環境保護署規定，危害性化學物質指環保署、相關機關或國際環境保護公約公告或定期修正之最新清單所列者，本附錄所列物質僅供參考，申請人應自行查詢相關法令有無更新管制物質。

（1）依下列環境保護及安全衛生法規所列之化學物質：

a.毒性化學物質管理法公告之毒性化學物質。

b.固定污染源空氣污染物排放標準及其他行業別空氣污染物排放標準所列之化學物質。但不包括燃燒設備排放之硫氧化物及氮氧化物。

c.放流水標準所列之化學物質。

d.有害事業廢棄物認定標準中製程有害事業廢棄物及毒性特性溶出程序（TCLP）溶出標準所列之化學物質。

e.土壤污染管制標準所列之化學物質。

f.地下水污染管制標準所列之化學物質。

g.作業環境空氣中有害化學物質容許濃度標準所列之有害化學物質，及勞工安全衛生法所稱危險物、有害物、有機溶劑、特定化學物質等。

（2）依下列國際環境保護公約所規範之化學物質：

a.斯德哥爾摩公約。

b.蒙特婁議定書。

c.其他國際環境保護公約。

（3）依環保署環境影響評估審查委員會指定之其他有害化學物質。

英文全名/化學式	中文名稱
(一)毒性化學物質管理法規定之物質	
1,1,2,2-Tetrachloroethane	1,1,2,2-四氯乙烷
1,1-Dichloroethylene	1,1-二氯乙烯
1,2,3-Trichloropropane	1,2,3-三氯丙烷
1,2,4-Trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	鄰苯二甲酸二烷基酯（C6-8 支鏈及直鏈，富含 C7）
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	鄰苯二甲酸二烷基酯（C7-11 支鏈及直鏈）
1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	二溴氯丙烷
1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)	1,2-二氯乙烷
1,2-Dichloroethylene	1,2-二氯乙烯
1,2-Dichloropropane	1,2-二氯丙烷
1,2-Diphenylhydrazine	1,2-二苯基聯胺
1,3-Butadiene	1,3-丁二烯
1,3-Dichlorobenzene	1,3-二氯苯
1,3-Dichloropropene	1,3-二氯丙烯
1,4-Dioxane	1,4-二氧陸圜

英文全名/化學式	中文名稱
1-Naphthylamine	1-萘胺
2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175)	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚
2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphenyl ether (BDE -183)	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚
2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphenyl ether (BDE-153)	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚
2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphenyl ether (BDE-154)	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚
2,2’,4,4’-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)	2,2',4,4'-四溴二苯醚
2,4,5-Trichlorophenol	2,4,5-三氯酚
2,4,6-Trichlorophenol	2,4,6-三氯酚
2,4-Dichlorophenol	2,4-二氯酚
2,4-Dinitrophenol	2,4-二硝基酚
2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)	乙二醇乙醚
2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)	乙二醇甲醚
2-Naphthylamine	2-萘胺
2-Naphthylamine acetate	2-萘胺醋酸鹽
2-Naphthylamine Hydrochloride	2-萘胺鹽酸鹽
3,3’-Dichlorobenzidine	二氯聯苯胺
3,3’-Dimethoxybenzidine	二甲氧基聯苯胺
3,3’-Dimethyl-[1,1’-biphenyl]-4,4’-diamine	鄰-二甲基聯苯胺
4,4’-Methylenedianiline	4,4’-二胺基二苯甲烷
4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT)	滴滴涕
4,4-isopropylidene diphenol (Bisphenol A)	雙酚 A
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)	4,4'-亞甲雙(2-氯苯胺)
4,6-Dinitro-o-cresol	4,6-二硝基-鄰-甲酚
Acetaldehyde	乙醛
Acetonitrile	乙腈
Acrolein	丙烯醛
Acrylamide	丙烯醯胺
Acrylonitrile	丙烯腈
Aldrin	阿特靈
Allyl alcohol	丙烯醇
Alpha (α) endosulfan	α-安殺番
Ammonium chromate	鉻酸銨
Ammonium dichromate	重鉻酸銨
Aniline	苯胺
Anthracene	蒽
Arsenic pentoxide	五氧化二砷
Arsenic trioxide	三氧化二砷
Asbestos	石綿
Barium chromate	鉻酸鋇
Benzene	苯
Benzidine	聯苯胺
Benzidine acetate	聯苯胺醋酸鹽

英文全名/化學式	中文名稱
Benzidine dihydrochloride	聯苯胺二鹽酸鹽
Benzidine dihydrofluoride	聯苯胺二氫氟酸鹽
Benzidine diperchlorate	聯苯胺二過氯酸鹽
Benzidine perchlorate	聯苯胺過氯酸鹽(一)
Benzidine perchlorate	聯苯胺過氯酸鹽(二)
Benzidine sulfate	聯苯胺硫酸鹽
Benzyl butyl phthalate (BBP)	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯
Benzyl chloride	苯甲氯
Beryllium	鈹
Beta (β) endosulfan	β-安殺番
Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether	二氯異丙醚
Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (BEEP)	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯
Bis(2-methoxyethyl) phthalate (BMEP)	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯
Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate (BBEP)	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯
Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (BMPP)	鄰苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯
Bis-Chloromethyl ether	二氯甲醚
Boron trifluoride	三氟化硼
Bromoform (Tribromomethane)	三溴甲烷(溴仿)
Butyl acrylate	丙烯酸丁酯
Butyraldehyde	丁醛
Cadmium	鎘
Cadmium carbonate	碳酸鎘
Cadmium chloride	氯化鎘
Cadmium cyanide	氰化鎘
Cadmium nitrate	硝酸鎘
Cadmium oxide	氧化鎘
Cadmium sulfate	硫酸鎘
Cadmium sulfide	硫化鎘
Calcium chromate	鉻酸鈣
Calcium cyanamide	氰胺化鈣
Calcium dichromate	重鉻酸鈣
Captafol	四氯丹
Captan	蓋普丹
Carbon disulfide	二硫化碳
Carbon tetrachloride	四氯化碳
Chlordane	可氯丹
Chlordecone	十氯酮
Chlorendic acid	六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸
Chlorine	氯
Chloroacetic acid	氯乙酸
Chlorobenzene	氯苯
Chlorobenzilate	克氯苯

英文全名/化學式	中文名稱
Chloroethane (Ethyl chloride)	氯乙烷
Chloroform	三氯甲烷
Chloromethane (Methyl chloride)	氯甲烷
Chloromethyl methyl ether	氯甲基甲基醚
Chloroprene	氯丁二烯
Chromated Copper Arsenate	鉻化砷酸銅
Chromium carbonyl	六羰化鉻
Chromium(VI) trioxide	三氧化鉻（鉻酸）
Copper Sodium cyanide	氰化銅鈉
Copper(I) cyanide	氰化亞銅
Copper(I) potassium cyanide	氰化鉀銅
Copper(II) cyanide	氰化銅
Crotonaldehyde (2-butenal)	巴豆醛（2-丁烯醛）
Cumene	異丙苯
Cupric chromate	鉻酸銅
Cupric dichromate	重鉻酸銅
Cyanazine	氰乃淨
Cyclohexane	環己烷
Cyhexatin	錫蟎丹
Daminozide	亞拉生長素
Decabromobiphenyl ether	十溴二苯醚
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
Dibenzofuran	二苯駢呋喃
Dibenzyl phthalate (DBZP)	鄰苯二甲酸二苄酯
Dibromomethane (Methylenebromide)	二溴甲烷
Dibutyl phthalate (DBP)	鄰苯二甲酸二丁酯
Dichlorobromomethane	二氯溴甲烷
Dichloromethane(Methylenechloride)	二氯甲烷
Dicyclohexyl Phthalate (DCHP)	鄰苯二甲酸二環己酯
Dicyclopentadiene	二環戊二烯
Dieldrin	地特靈
Diethanolamine	二乙醇胺
Diethyl phthalate (DEP)	鄰苯二甲酸二乙酯
Diethylamine, N-nitroso-(Nitrosamine diethyl)	N-亞硝二乙胺(二乙亞硝胺)
Di-iso-butyl Phthalate (DIBP)	鄰苯二甲酸二異丁酯
Di-isodecyl phthalate (DIDP)	鄰苯二甲酸二異癸酯
Di-isononyl phthalate (DINP)	鄰苯二甲酸二異壬酯
Di-iso-octyl Phthalate (DIOP)	鄰苯二甲酸二異辛酯
Dimethyl phthalate (DMP)	鄰苯二甲酸二甲酯
Dimethyl sulfate	硫酸二甲酯
Dimethylcarbamyl chloride	二甲基胺甲醯氯
Di-n-hexyl Phthalate (DNHP)	鄰苯二甲酸二己酯

英文全名/化學式	中文名稱
Di-n-nonyl phthalate (DNP)	鄰苯二甲酸二正壬酯
Di-n-octyl phthalate (DNOP)	鄰苯二甲酸二辛酯
Dinoseb	達諾殺
Di-n-pentyl Phthalate (DNPP)	鄰苯二甲酸二戊酯
Di-n-propyl Phthalate (DPP)	鄰苯二甲酸二丙酯
Diphenyl phthalate (DPP)	鄰苯二甲酸二苯酯
Diphenylamine	二苯胺
Endosulfan (Technical endosulfan)	安殺番
Endosulfan sulfate	安殺番硫酸鹽
Endrin	安特靈
Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane)	環氧氯丙烷
Ethyl chloroformate	氯甲酸乙酯
ethyl sulfate (Diethyl sulfate)	硫酸乙酯(硫酸二乙酯)
Ethylbenzene	乙苯
Ethylene dibromide	二溴乙烷(二溴乙烯)
Ethylene oxide	環氧乙烷
Ethyleneimine	次乙亞胺
Fenchlorphos	樂乃松
Ferric chromate	鉻酸鐵
Fluorine	氟
Folpet	福爾培
Formaldehyde	甲醛
Formamide	甲醯胺
Heptachlor	飛佈達
Hexabromobiphenyl	六溴聯苯
Hexachloro-1,3-butadiene	六氯-1,3-丁二烯
Hexachlorobenzene	六氯苯
Hexachlorocyclohexane	蟲必死
Hexachloroethane	六氯乙烷
Hexachloronaphthalene	六氯萘
Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3, 3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane)	2,2'-二羥-3,3',5,5',6,6'-六氯二苯甲烷
Hexamethylphosphoramide (HMPA)	六甲基磷酸三胺
Hexyl 2-ethylhexyl phthalate (HEHP)	鄰苯二甲酸己基 2-乙基己基酯
Hydrazine	聯胺
Hydrogen cyanide	氰化氫
Lead chromate	鉻酸鉛
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)	鉬鉻紅
Lead chromate oxide	鉻酸氧鉛
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	硫鉻酸鉛
Leptophos	福賜松
Lindane (γ-BHC, or γ-HCH)	靈丹

英文全名/化學式	中文名稱
Lithium chromate	鉻酸鋰
Lithium dichromate	重鉻酸鋰
Lithium perfluorooctane sulfonate	全氟辛烷磺酸鋰鹽
m-Aminotoluene	間-甲苯胺
m-Cresol	間-甲酚
Mercuric dichromate	重鉻酸汞
Mercury	汞
Methyl hydrazine	甲基聯胺
Methyl iodide	碘甲烷
Methyl isobutyl ketone	甲基異丁酮
Methyl isocyanate	異氰酸甲酯
Methylmercury	甲基汞
Methyl-tert-butyl ether	甲基第三丁基醚
Mirex	滅蟻樂
Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)	鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯
Monofluoroacetamide	氟乙醯胺
Mono-n-Butyl phthalate (MNBP)	鄰苯二甲酸單丁酯
m-Toluylenediamine(m-Tolylene-diamine ; toluene- 2,4-diamine)	2,4-甲苯二胺
N,N-Dimethyl formamide	二甲基甲醯胺
Nickel carbonyl	四羰化鎳
Nitrilotri acetic acid	三乙酸基氨
Nitrobenzene	硝苯
Nitrofen	護谷
Nitrosodimethylamine (DMNA)	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）
N-Nitroso-N-methylurea	N-亞硝-正-甲脲
Nonylphenol	壬基酚
Nonylphenol polyethylene glycol ether	壬基酚聚乙氧基醇
o-Aminotoluene	鄰-甲苯胺
Octabromodiphenyl ether	八溴二苯醚
Octachloronaphthalene	八氯萘
o-Dichlorobenzene (1,2-Dichloro benzene)	鄰-二氯苯
P-Aminobiphenyl	對-胺基聯苯
P-Aminobiphenyl Hydrochloride	對-胺基聯苯鹽酸鹽
p-Aminotoluene	對-甲苯胺
p-Chloro-o-toluidine	對-氯-鄰-甲苯胺
Pentabromodiphenyl ether	五溴二苯醚
Pentachlorobenzene	五氯苯
Pentachloronitrobenzene	五氯硝苯
Pentachlorophenol	五氯酚
Perfluorooctane sulfonic acid	全氟辛烷磺酸

英文全名/化學式	中文名稱
Perfluorooctane sulfonyl fluoride	全氟辛烷磺醯氟
Phosgene	光氣
Phosphine	磷化氫
Phosphorus trichloride	三氯化磷
Phthalic anhydride	鄰苯二甲酐
P-Nitrobiphenyl	對-硝基聯苯
Polychlorinated biphenyls	多氯聯苯
Potassium chromate	鉻酸鉀
Potassium cyanide	氰化鉀
Potassium dichromate	重鉻酸鉀
Propane sultone	1,3-丙烷礦內酯
Propargyl alcohol	炔丙醇(2-丙炔-1-醇)
Propyleneimine	丙烯亞胺
Pyridine	吡啶
Silver chromate	鉻酸銀
Silver cyanide	氰化銀
Sodium chromate	鉻酸鈉
Sodium cyanide	氰化鈉
Sodium dichromate	重鉻酸鈉
Sodium pentachlorophenate	五氯酚鈉
Stannic chromate	鉻酸錫
Strontium chromate	鉻酸鍶
Styrene oxide	氧化苯乙烯
Tetrachloroethylene	四氯乙烯
Thiosemicarbazide 1-amino-2-thiourea	胺基硫脲
Thiourea (thiocarbamide)	硫脲
Toluene diisocyanate (mixed isomers)	二異氰酸甲苯
Toluene-2,4-diisocyanate	2,4-二異氰酸甲苯
Toluylenediamines(mixed isomers) ; (toluene,diamino-) (mixed isomers)	甲苯二胺(同分異構物混合物)
Toxaphene	毒殺芬
Tributyltin acetate	醋酸三丁錫
Tributyltin bromide	溴化三丁錫
Tributyltin chloride	氯化三丁錫
Tributyltin fluoride	氟化三丁錫
Tributyltin hydride	氫化三丁錫
Tributyltin laurate	月桂酸三丁錫
Tributyltin maleate	順丁烯二酸三丁錫
Tributyltin oxide Bis(tributyltin)oxide	氧化三丁錫
Trichloroethylene	三氯乙烯
Trichloromethyl benzene	三氯甲苯
Triethylamine	三乙胺

英文全名/化學式	中文名稱
Trinickel disulfide	次硫化鎳
Tri-n-propylethyltin	三正丙基乙錫
Tri-n-propylisobutyltin	三正丙基異丁錫
Tri-n-propyl-n-butyltin	三正丙基正丁錫
Tri-n-propyltin iodide	碘化三正丙錫
Triphenylbenzyltin	三苯基苄錫
Triphenylmethyltin	三苯基甲錫
Triphenyl-p-tolyltin	三苯基-對-甲苯錫
Triphenyltin acetate	醋酸三苯錫
Triphenyltin bromide	溴化三苯錫
Triphenyltin chloride	氯化三苯錫
Triphenyltin fluoride	氟化三苯錫
Triphenyltin hydroxide	氫氧化三苯錫
Triphenyltin iodide	碘化三苯錫
Triphenyl-α-naphthyltin	三苯基-α-萘錫
Tripropyltin bromide	溴化三丙錫
Tripropyltin chloride	氯化三丙錫
Tripropyltin fluoride	氟化三丙錫
Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate	三(2,3-二溴丙基)-磷酸酯
Tris(2-chloroethyl) phosphate(TCEP)	三 2-(氯乙基)磷酸酯
Tritolyltin bromide	溴化三甲苯錫
Tritolyltin chloride	氯化三甲苯錫
Tritolyltin fluoride	氟化三甲苯錫
Tritolyltin hydroxide	氫氧化三甲苯錫
Tritolyltin iodide	碘化三甲苯錫
Tritriphenylstannyl-methane	參(三苯錫)甲烷
Trixylyltin bromide	溴化三苯錫
Trixylyltin chloride	氯化三苯錫
Trixylyltin fluoride	氟化三苯錫
Trixylyltin iodide	碘化三苯錫
Vinyl acetate	醋酸乙烯酯
Vinyl bromide	溴乙烯
Vinyl Chloride	氯乙烯
Zinc chromate (Zinc chromate hydroxide)	鉻酸鋅（鉻酸鋅氫氧化合物）
Zinc cyanide	氰化鋅
Zinc dichromate	重鉻酸鋅
α -Bromobenzyl cyanide	α-氰溴甲苯
α-Chloroacetophenone (w-Chloroacetophenone)	α-苯氯乙酮 （w-苯氯乙酮）
β-Propiolactone	β-丙內酯
(二)其他法令規定之危害性化學物質	
Acenaphthalene	苊烯
Acetic acid	醋酸

英文全名/化學式	中文名稱
Acetic anhydride	乙酸酐
Acetone	丙酮
Acetylene	乙炔
Acetylene tetrabromide	四溴化乙炔 (1,1,2,2-四溴乙烷)
Acrylic acid	丙烯酸
Alachlor	拉草
Allyl chloride	氯丙烯
Allyl glycidyl ether (AGE)	丙烯基缩水甘油醚
Aluminum	鋁
4-Aminodiphenyl	4-胺基聯苯
2-Aminopyridine	2-胺吡啶
Ammonia	氨
Ammonium chloride	氯化氨
Ammonium nitrate	硝酸銨
Ammonium perchlorate	過氯酸銨
Amosite	褐石綿
Amyl acetate	乙酸戊酯
n-Amyl acetate	乙酸正戊酯
o-Anisidine	鄰-甲氧苯胺
Antimony	銻
ANTU (α-Naphthyl thiourea)	安妥 (α-萘硫脲)
Arsenic	砷
Arsine	砷化氫
Auramine	奧黃
Azinphos methyl	谷速松
Barium	鋇
Barium peroxide	過氧化鋇
Benomyl	免賴得
Benzo(a) anthracene	苯(a)駢蒽
Benzo(a) pyrene	苯(a)芘
Benzo(b) fluoranthene	苯(b)二苯駢
Benzoyl peroxide	過氧苯醯
Benzoyl peroxide	過氧化二苯甲醯
Benzyl chloride	氯化甲基苯
Biphenyl	聯苯
Bipyridyl (Bipyridine)	聯吡啶
Bis-2-chloroethyl ethers	2-氯乙醚
Boron	硼
Boron tribromide	三溴化硼
Bromine	溴
Bromine pentafluoride	五氟化溴
Butachlor (n-butoxymethyl-2-chloro-2, 6-diethylacetanilide)	丁基拉草

英文全名/化學式	中文名稱
Butadiene	丁二烯
Butane	丁烷
1-Butanol	1-丁醇
2-Butanol	2-丁醇
1-Butanethiol	1-丁硫醇
Butyl acetate	乙酸丁酯
n-Butyl acetate	乙酸正丁酯
n-Butyl lactate	乳酸正丁酯
Butylamine	丁胺
o-sec-Butyl phenol	鄰-第二丁酚
n-Butyl glycidyl ether (BGE)	正丁基縮水甘油醚
Calcium arsenate	砷酸鈣
Calcium carbide	碳化鈣
Calcium hydroxide	氫氧化鈣
Calcium hypochlorite	次氯酸鈣
Calcium oxide	氧化鈣
Calcium phosphide	磷化鈣
Camphor (Synthetic)	合成樟腦
Caprolactam	己內醯胺
Carbaryl	加保利
Carbendazim	貝芬替
Carbofuran	加保扶
Carbon black	碳黑
Carbon dioxide	二氧化碳
Carbon monoxide	一氧化碳
Carbosulfan	丁基加保扶
Cesium hydroxide	氫氧化銫
Chlorinated diphenyl oxide	氧化氯二苯
Chlorine dioxide	二氧化氯
Chlorine trifluoride	三氟化氯
Chloro acetaldehyde	一氯乙醛
2-Chloro-1,3-butadiene	2-氯-1,3-丁二烯
Chloro difluoro methane	氯二氟甲烷
1-Chloro-2,3-epoxy propane	1-氯-2,3-環氧丙烷
Chloro pentafluoro ethane	氯五氟乙烷
Chloro picrin (Trichloro nitromethane)	氯化苦 (三氯硝甲烷)
Chloroacetaldehyde	氯乙醛
Chloroacetyl chloride	氯乙醯氯
Chlorobromomethane	溴氯甲烷
2-Chloro ethanol	2-氯乙醇
Chloromethane	氯化甲烷
1-Chloro-1-nitropropane	1-氯-1-硝基丙烷

英文全名/化學式	中文名稱
o-Chlorostyrene	鄰-氯苯乙烯
o-Chlorotoluene	鄰-氯甲苯
Chromium	鉻
Chrysene	屈
cis-1,2-Dichloroethylene	順-1,2-二氯乙烯
Cobalt	鈷
Copper	銅
Creosote	木榴油
Cresol	甲酚
Crocidolite	青石棉
Cyanamide	氰胺 (氰滿素)
Cyclo hexanone	環己酮
Cyclohexanol	環己醇
Cyclohexylamine	環己胺
1,3-Cyclopentadiene	1,3 環戊二烯
Cyclopentane	環戊烷
Decaborane	十硼烷
Demeton	滅賜松
Diacetone alcohol	二丙酮醇
Diazinon	大利松
Diazodinitrophenol	重氮基酚
Diazomethane	重氮甲烷
Dibenzo(a)anthracene	二苯駢(a)駢蒽
Diborane	二硼烷
Dibutyl phosphate	磷酸二丁酯
Dicalcium Phosphate	磷酸二鈣
Dichloro acetylene	二氯乙炔
Dichloro difluoro methane	二氯二氟甲烷
Dichloro monofluoro methane	二氯氟甲烷
2,2-Dichloro propionic acid	2,2-二氯丙酸
Dichloro tetrafluoro ethane	對-四氟二氯乙烷
Dichlorobenzene	二氯苯
1,4-Dichlorobenzene	1,4-二氯苯
3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenylmethane (Diaminodiphenylmethane)	3,3-二氯-4,4-二胺基苯化甲烷
1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin	1,3-二氯-5,5-二甲基乙內醯
1,1-Dichloro ethane	1,1-二氯乙烷
trans-1,2-Dichloroethylene	反-1,2-二氯乙烯
Dichloroethyl ether	二氯乙醚
Dichloropropanol	二氯丙醇
Dichlorotetrafluoroethane	四氟二氯乙烷
Dichromic acid	重鉻酸

英文全名/化學式	中文名稱
1,1-Dichloro-1-nitroethane	1,1-二氯-1-硝基乙烷
2,6-Dichlorophenol	2,6-二氯酚
2,4-D (2,4-Dichloro phenoxy acetic acid)	2,4-地 (2,4-二氯苯氧乙酸)
Dicrotophos	雙特松
2-Diethyl amino ethanol	2-二乙胺基乙醇
Diethyl ketone	二乙酮
Diethyl phthalate	鄰-苯二甲酸二乙酯
Diethylamine	二乙胺
Diethylene triamine	二次乙基三胺
Difluoro dibromo methane	二溴二氟甲烷
Diglycidyl ether (DGE)	縮水甘油醚
Diisobutyl ketone	二異丁酮
Diisopropyl amine	二異丙胺
N,N-Dimethyl acetamide	N,N-二甲基乙醯胺
N,N-Dimethyl aniline	N,N-二甲基苯胺
Dimethyl dichloro vinyl phosphate (DDVP)	二氯松
Dimethyl disulfide	二硫化甲基
1,1-dimethylhydrazine (UDMH)	1,1-二甲基聯胺
Dimethyl sulfate	二甲基硫酸鹽
Dimethyl sulfide	硫化甲基
Dimethylamine	二甲胺
Dinitro benzene	二硝基苯
m-dinitrobenzene	間-二硝基苯
Dinitroethyleneglycol	二硝基乙二醇
Dinitrotoluene	二硝基甲苯
2,4-Dinitrotoluene	2,4-二硝基甲苯
Dioxathion	大克松
Dipropyl ketone	二丙酮
Dipropylene glycol methyl ether	二丙二醇甲醚
Disulfoton	二硫松
Divinyl benzene (DVB)	二乙烯苯
Epichlorohydrin	3-氯-1,2-環氧丙烷
EPN	一品松
1,2-Epoxypropane	1,2-環氧丙烷
2,3-Epoxyl-1- propanol (Glycidol)	2,3-環氧丙醇
Ethane	乙烷
Ethanolamine	乙醇胺
Ethene	乙烯
Ethion	愛殺松
Ethyl acetate	乙酸乙酯
Ethyl acrylate	丙烯酸乙酯
Ethyl alcohol	乙醇

英文全名/化學式	中文名稱
Ethyl amyl ketone	乙基正戊酮
Ethyl bromide	溴乙烷
Ethyl butyl ketone	乙基丁基酮
Ethyl ether	乙醚
Ethyl formate	甲酸乙酯
Ethyl mercaptan	乙硫醇
Ethyl mercury	乙基汞
Ethylamine	乙胺
Ethylene diamine	乙二胺
Ethylene glycol	乙二醇
Ethylene glycol monobutyl ether	乙二醇丁醚
Ethylene glycol monoethyl ether acetate	乙二醇乙醚醋酸酯
Ethylene glycol monomethyl ether acetate	乙二醇甲醚醋酸酯
Ethylene thiourea	乙硫脲
4-Ethylmorpholine	N-乙基-1,4-氧氮陸圜
Ferro vanadium	釩亞鐵合金
Fluoranthene	苯駢苊
Fluoro trichloromethane	氟三氯甲烷
Formic acid	甲酸
Furfural	呋喃甲醛
Furfuryl alcohol	2-呋喃甲醇
Germanium tetrahydride	四氫化鍺
Glutaraldehyde	戊二醛
Glyphosate (n-(phosphonomethyl) glycine)	嘉磷塞
Hafnium	鉿
n-Heptane	正庚烷
Hexachloro butadiene	六氯丁二烯
Hexachloro cyclopentadiene	六氯環戊二烯
Hexafluoro acetone	六氟丙酮
Hexamethylene diisocyanate (HDI)	二異氰酸環己烷
Hexane	己烷
n-Hexane	正己烷
Hexylene glycol	2-甲基-2,4-戊二醇
Hydrocyanic acid	氫氰酸
Hydrogen	氫
Hydrogen bromide	溴化氫
Hydrogen chloride	氯化氫
Hydrogen fluoride	氟化氫
Hydrogen peroxide	過氧化氫
Hydrogen selenide	硒化氫
Hydrogen sulfide	硫化氫
Hydroquinone	氫醌 (苯二酚)

英文全名/化學式	中文名稱
Indeno(1,2,3-cd) pyrene	茚酮(1,2,3-cd)芘
Indium	銦
Iodine	碘
Iron oxide	氧化鐵
Iron penta carbonyl	五羰鐵
Isoamyl acetate	乙酸異戊酯
Isoamyl alcohol	異戊醇
Isobutyl acetate	乙酸異丁酯
Isobutyl alcohol	異丁醇
Isooctyl alcohol	異辛醇
Isophorone	異佛爾酮
Isophorone diisocyanate (IPDI)	二異氰酸異佛爾酮
2-Isopropoxy ethanol	2-異丙氧基乙醇
Isopropyl acetate	乙酸異丙酯
Isopropyl alcohol	異丙醇
n-Isopropyl aniline	異丙基苯胺
Isopropyl ether	異丙醚
Isopropyl glycidyl ether (IGE)	異丙基縮水甘油醚
Isopropylamine	異丙胺
Ketene	乙烯酮
Lead	鉛
Lead arsenate	砷酸鉛
Lead Azide	疊氮化鉛
Lead Styphnate	史蒂芬酸鉛
Linen	亞麻
Lithium	鋰
Lithium hydride	氫化鋰
Magenta	苯胺紅
Magnesium	鎂
Magnesium oxide	氧化鎂
Malathion	馬拉松
Maleic anhydride	順-丁烯二酐
Manganese	錳
Manganese cyclo pentadienyl tricarbonyl	碳三羧基戊基錳
Mercuric Fulminate	雷汞
Mesityl oxide	異亞丙基丙酮
Methacrylic acid	甲基丙烯酸
Methamidophos	達馬松
4-Methoxy phenol	4-甲氧苯酚
Methyl 2-cyanoacrylate	2-氰基丙烯酸甲酯
Methyl acetate	乙酸甲酯
Methyl acetylene	丙炔

英文全名/化學式	中文名稱
Methyl acrylate	丙烯酸甲酯
Methyl acrylonitrile	甲基丙烯腈
Methyl alcohol	甲醇
N-Methyl aniline	N-甲苯胺
Methyl bromide	甲基溴化物
Methyl butyl ketone	甲丁酮
Methyl cyclo hexanone	甲基環己酮
Methyl cyclo pentadienyl manganese tricarbonyl	甲基環戊二烯三羰基錳
Methyl cyclohexane	甲基環己烷
Methyl cyclohexanol	甲基環己醇
Methyl ethyl ketone	丁酮
Methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO)	過氧化丁酮
Methyl formate	甲酸甲酯
Methyl isoamyl ketone	甲基異戊酮
Methyl isobutyl carbinol	4-甲基-2 戊醇
Methyl isopropyl ketone	甲基異丙酮
Methyl mercaptan	甲硫醇
Methyl methacrylate	甲基丙烯酸甲酯
Methyl n-amyl ketone	甲基正戊酮
Methyl parathion	甲基巴拉松
Methyl propyl ketone	甲丙酮
α-Methyl styrene	α-甲基苯乙烯
Methylal	二甲氧甲烷
Methylamine	甲胺
Methylene bisphenyl diisocyanate (Methylene bisphenyl isocyanate)	4,4-二異氰酸二苯甲烷
Methylene chloride	氯化次甲基
Mineral spirit (Mineral thinner， petroleum spirit， white spirit)	礦油精
Molybdenum	鉬
Monomethyl amine	一甲胺
Morpholine	1,4-氧氮陸圜 (嗎啉)
Naphtha (Coal tar)	石油精
Naphthalene	萘
Nickel	鎳
Nicotine	菸鹼
Nitric acid	硝酸
Nitric oxide	一氧化氮
p-Nitroaniline	對-硝苯胺
p-Nitrochlorobenzene	對-硝基氯苯
4-Nitro diphenyl	4-硝基聯苯
Nitroethane	硝基乙烷
Nitrogen dioxide	二氧化氮

英文全名/化學式	中文名稱
Nitrogen trifluoride	三氟化氮
Nitroglycerin	硝化甘油
Nitroglycol	硝化乙二醇
Nitromethane	硝基甲烷
1-Nitropropane	1-硝基丙烷
2-Nitropropane	2-硝基丙烷
Nitrotoluene	硝基甲苯
Nonane	壬烷
Octane	辛烷
Osmium tetroxide	四氧化鋨
Oxalic acid	草酸
Oxygen difluoride	氟化氧
Ozone	臭氧
p-Anisidine	對-甲氧苯胺
Paraldehyde	三聚乙醛
Paraquat	巴拉刈
Parathion	巴拉松
PCDDs/PCDFs	戴奧辛化合物
p-Dimethylaminoazobenzene	對-二甲胺基偶氮苯
Pentaborane	五硼烷
Pentachloro naphthalene	五氯萘
Pentachloronaphthalene	五氯化萘
Pentane	戊烷
Perchloro methyl mercaptan	過氯甲基硫醇
Perchloryl fluoride	過氯酸氟
Peroxyacetic acid	過醋酸
Petroleum benzine	輕油精
Petroleum ether	石油醚
Pheno thiazine	分塞嗪
Phenol	酚
Phenyl ether	苯醚
Phenyl glycidyl ether (PGE)	苯基縮水甘油醚
Phenyl hydrazine	苯肼
Phenyl mercaptan	苯硫醇
Phenyl phosphine	苯膦
Phenylenediamine	苯二胺
Phenylethane	苯乙烷
Phorate	福瑞松
Phosdrin (Mevinphos)	美文松
Phosphoric acid	磷酸
Phosphorodithioic	二硫磷酸

英文全名/化學式	中文名稱
Phosphorothioic acid esters	硫磷酸酯類
Phosphorus	磷
Phosphorus oxychloride	氧氯化磷
Phosphorus pentachloride	五氯化磷
Phosphorus pentasulfide	五硫化磷
Phthalodinitrile	二腈苯
o-Phthalodinitrile	鄰-二腈苯
2-Picoline	2-皮考林
Picric acid (Trinitrophenol)	苦味酸 (三硝基酚)
Piperazine dihydrochloride	二氫氯化六氫吡啶
Platinum Metal	鉑
p-Nitro chloro benzene	對-硝基氯苯
Polyurethane	聚氨基甲酸脂
Potassium	鉀
Potassium chlorate	氯酸鉀
Potassium nitrate	硝酸鉀
Potassium perchlorate	過氯酸鉀
Potassium peroxide	過氧化鉀
p-Phenylene diamine	對-苯二胺
Propane	丙烷
1-Propanol	1-丙醇
Propionic acid	丙酸
n-Propyl acetate	乙酸丙酯
n-Propyl nitrate (NPN)	硝酸丙酯
Propylene glycol dinitrate	丙二醇二硝酸酯
Propylene glycol monomethyl ether	丙二醇甲醚
Pyrethrum	除蟲菊
Quinone	醌
Resorcinol	間-苯二酚 (雷瑣辛)
Rhodium	銠
Rotenone	魚藤精
sec-Amyl acetate	乙酸第二戊酯
sec-Butyl acetate	乙酸第二丁酯
sec-Hexyl acetate	乙酸第二己酯
Selenium	硒
Selenium hexafluoride	六氟化硒
Silicon dioxide	二氧化矽
Silicon hydride (Silane)	四氫化矽
Silver	銀
Sodium	鈉
Sodium azide	疊氮化鈉
Sodium bisulfite	亞硫酸氫鈉

英文全名/化學式	中文名稱
Sodium chlorate	氯酸鈉
Sodium chlorite	亞氯酸鈉
Sodium dithionite	二亞硫磺酸鈉
Sodium fluoro acetate	氟乙酸鈉
Sodium hydroxide	氫氧化鈉
Sodium nitrate	硝酸鈉
Sodium perchlorate	過氯酸鈉
Sodium peroxide	過氧化鈉
Sodium Tripoly Phosphate	三聚磷酸鈉
Stibine (antimony hydride)	氫化銻
Stoddard solvent (White spirits)	斯多德爾溶劑
Styrene	苯乙烯
Sulfide	硫化物
Sulfur dioxide	二氧化硫
Sulfur hexafluoride	六氟化硫
Sulfur monochloride	一氯化硫
Sulfur pentafluoride	五氟化硫
Sulfur tetrafluoride	四氟化硫
Sulfuric acid	硫酸
Sulfuryl fluoride	氟化硫醯
Talc	滑石
Tantalum	鉭
Tellurium	碲
TEPP	帖普
Terphenyls	聯三苯
tert-Butyl acetate	乙酸第三丁酯
tert-Butyl alcohol	第三丁醇
p-tert-Butyl toluene	對-第三丁基甲苯
1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoro ethane	1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2- difluoro ethane	1,1,2,2-四氯-1,2-二氟乙烷
Tetra hydrofuran (THF)	四氫呋喃
Tetra methyl ammonium- hydroxide	氫氧化四甲銨
Tetra methyl lead	四甲基鉛
Tetrachloro naphthalene	四氯萘
Tetrachlorobenzene	四氯苯
Tetraethyl lead	四乙基鉛
Tetramethyl succinonitrile	四甲基琥珀腈
Tetranitro methane	四硝甲烷
Tetrasodium pyro-phosphate	焦磷酸四鈉
Thioglycollic acid	乙硫醇酸
Thiols	硫醇
Thionyl chloride	氯化亞硫醯

英文全名/化學式	中文名稱
Thiram	得恩地
Tin	錫
Tin oxide	氧化錫
Titanium dioxide	二氧化鈦
Titanium tetrachloride	四氯化鈦
Toluene	甲苯
Toluene-2,4-diamine	2,4-二胺甲苯
Toluene-2,6-diisocyanate (TDI)	2, 6-二異氰酸甲苯
2,4,6-Tribromophenol	2,4,6-三溴酚
Tributyl phosphate (TBP)	磷酸三丁酯
Trichloro acetic acid (TCA)	三氯乙酸
1,1,1-Trichloro ethane (methyl chloroform)	1,1,1-三氯乙烷
1,1,2-Trichloro ethane	1,1,2-三氯乙烷
Trichloro naphthalene	三氯萘
Trichlorobenzene	三氯苯
Trichloroethane	三氯乙烷
Trichloropropane	三氯丙烷
1,1,2-Trichloro- 1,2,2-trifluoro ethane	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷
Trifluoro bromomethane	三氟溴甲烷
Trimellitic anhydride	1,2,4-苯三甲酸酐
Trimethyl benzene	三甲苯
Trimethyl phosphite	亞磷酸三甲酯
Trimethylamine	三甲胺
Trinitrobenzene	三硝基苯
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	2,4,6-三硝基甲苯
Triorthocresyl phosphate (TOCP)	三鄰甲苯基磷酸酯
Triphenyl amine	三苯基胺
Triphenyl phosphate	磷酸三苯酯
Tungstene	鎢
Turpentine	松節油
Uranium	鈾
n-Valeraldehyde	戊醛
Vanadium Pentaoxide	五氧化二釩
Vinyl cyclohexene dioxide	二氧化環己烯乙烯
Vinyl toluene	乙烯基甲苯
Warfarin	殺鼠靈
Xylene	二甲苯
Xylidine	二甲苯胺
Yttrium	釔
Zinc	鋅
Zinc chloride	氯化鋅
Zinc oxide	氧化鋅

英文全名/化學式	中文名稱
Ziram	二甲基二硫氨基甲酸鋅
Bromochloromethane	一氯一溴甲烷
CFC-11	一氟三氯甲烷
CFC-111	一氟五氯乙烷
CFC-112	二氟四氯乙烷
CFC-113	三氟三氯乙烷
CFC-114	四氟二氯乙烷
CFC-115	五氟一氯乙烷
CFC-12	二氟三氯甲烷
CFC-13	三氟一氯甲烷
CFC-211	一氟七氯丙烷
CFC-212	二氟六氯丙烷
CFC-213	三氟五氯丙烷
CFC-214	四氟四氯丙烷
CFC-215	五氟三氯丙烷
CFC-216	六氟二氯丙烷
CFC-217	七氟一氯丙烷
Chlordecone	十氯酮 (克敵康)
4,4-Dichlorodiphenyl-triichloroethane (DDT)	二氯二苯基三氯乙烷 (滴滴涕)
Halon-1211	二氟一氯一溴甲烷
Halon-1301	三氟一溴甲烷
Halon-2402	四氟二溴乙烷
HBFC-121B4	一氟四溴乙烷
HBFC-122B3	二氟三溴乙烷
HBFC-123B2	三氟二溴乙烷
HBFC-124B1	四氟一溴乙烷
HBFC-131B3	一氟三溴乙烷
HBFC-132B2	二氟二溴乙烷
HBFC-133B1	三氟一溴乙烷
HBFC-141B2	一氟二溴乙烷
HBFC-142B1	二氟一溴乙烷
HBFC-151B1	一氟一溴乙烷
HBFC-21B2	一氟二溴甲烷
HBFC-221B6	一氟六溴丙烷
HBFC-222B5	二氟五溴丙烷
HBFC-223B4	三氟四溴丙烷
HBFC-224B3	四氟三溴丙烷
HBFC-225B2	五氟二溴丙烷
HBFC-226B1	六氟一溴丙烷
HBFC-22B1	二氟一溴甲烷
HBFC-231B5	一氟五溴丙烷
HBFC-232B4	二氟四溴丙烷

英文全名/化學式	中文名稱
HBFC-233B3	三氟三溴丙烷
HBFC-234B2	四氟二溴丙烷
HBFC-235B1	五氟一溴丙烷
HBFC-241B4	一氟四溴丙烷
HBFC-242B3	二氟三溴丙烷
HBFC-243B2	三氟二溴丙烷
HBFC-244B1	四氟一溴丙烷
HBFC-251B3	一氟三溴丙烷
HBFC-252B2	二氟二溴丙烷
HBFC-253B1	三氟一溴丙烷
HBFC-261B2	一氟二溴丙烷
HBFC-262B1	二氟一溴丙烷
HBFC-271B1	一氟一溴丙烷
HBFC-31B1	一氟一溴甲烷
HCFC-121	一氟四氯乙烷
HCFC-122	二氟三氯乙烷
HCFC-123	三氟二氯乙烷
HCFC-124	四氟一氯乙烷
HCFC-131	一氟三氯乙烷
HCFC-132	二氟二氯乙烷
HCFC-133	三氟一氯乙烷
HCFC-141b	一氟二氯乙烷
HCFC-142b	二氟一氯乙烷
HCFC-151	一氟一氯乙烷
HCFC-21	一氟二氯甲烷
HCFC-22	二氟一氯甲烷
HCFC-221	一氟六氯丙烷
HCFC-222	二氟五氯丙烷
HCFC-223	三氟四氯丙烷
HCFC-224	四氟三氯丙烷
HCFC-225	五氟二氯丙烷
HCFC-225ca	五氟二氯丙烷
HCFC-225cb	五氟二氯丙烷
HCFC-226	六氟一氯丙烷
HCFC-231	一氟五氯丙烷
HCFC-232	二氟四氯丙烷
HCFC-233	三氟三氯丙烷
HCFC-234	四氟二氯丙烷
HCFC-235	五氟一氯丙烷
HCFC-241	一氟四氯丙烷
HCFC-242	二氟三氯丙烷
HCFC-243	三氟二氯丙烷

英文全名/化學式	中文名稱
HCFC-244	四氟一氯丙烷
HCFC-251	一氟三氯丙烷
HCFC-252	二氟二氯丙烷
HCFC-253	三氟一氯丙烷
HCFC-261	一氟二氯丙烷
HCFC-262	二氟一氯丙烷
HCFC-271	一氟一氯丙烷
HCFC-31	一氟一氯甲烷
Heptabromodiphenyl ether	七溴二苯醚
Heptachlor	飛佈達
Hexabromobiphenyl	六溴聯苯
Hexabromodiphenyl ether	六溴二苯醚
Hexachlorobenzene (HCB)	六氯苯
α-Hexachlorocyclohexane	α-六氯環己烷
β-Hexachlorocyclohexane	β-六氯環己烷
Lindane	靈丹
Methyl bromide	溴化甲烷
Mirex	滅蟻樂
PCDDs/PCDFs	戴奧辛化合物
Pentabromodiphenyl ether	五溴二苯醚
Pentachlorobenzene	五氯苯
Perfluorooctane sulfonate	全氟辛烷磺酸鹽
Perfluorooctane sulfonic acid	全氟辛烷磺酸
Perfluorooctane sulfonyl fluoride	全氟辛基磺醯氟
Polychlorinated biphenyls (PCB)	多氯聯苯
Tetrabromodiphenyl ether	四溴二苯醚
Toxaphene	毒殺芬
1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)	三氯乙烷

附件 3-6　土地使用契約書

立契約人　　管理人：高雄市政府（以下簡稱甲方）

法定代理人：陳其邁

代理機關：高雄市政府經濟發展局

法定代理人：廖泰翔

使用人：○○○○（以下簡稱乙方）

法定代理人：

本契約土地使用事項，經甲乙雙方一致同意訂立條款如後，以資共同遵守：

第 1 條　租賃標的

高雄市仁武區○○段○○小段○○地號等○筆土地（以下簡稱租賃標的），面積計○○○○平方公尺。

第 2 條　使用期間

自本契約簽訂日即民國○○○年○○月○○日起至乙方與台灣糖業股份有限公司所簽訂「台糖公司土地設定地上權契約書」契約關係消滅止。

第 3 條　續約

本契約期滿得續約，但乙方應於本契約屆滿前 1 個月，以書面通知甲方申請續約，並經甲方同意後由雙方簽訂新約或展延契約。契約屆滿前，甲方未同意續約者，本契約即告終止。

第 4 條　完成使用保證金

一、乙方應於接獲繳款通知之次日起 2 個月內，繳納完成使用保證金（新台幣○○○○元整）予甲方指定之帳戶或受託辦理機構。

二、前項完成使用保證金，乙方得以現金、銀行定期存單質押或銀行連帶保證書作為擔保種類。銀行連帶保證書之有效期至少應自第一期租金繳交日起三年九個月。

三、乙方依本契約第 5 條第 5 項規定完成使用者，得向甲方申請無息退還完成使用保證金。

第 5 條　使用限制

一、 乙方同意確實遵照承租土地入區審查時所提出之「投資營運計畫書」於預定完成使用期限內盡其最大努力，具體實現該計畫之內容。但因產業發展趨勢、經濟變遷或其他企業營運考量，致需變更或調整「投資營運計畫書」之內容者，不在此限。

二、 前項但書情形，乙方應提出變更或調整後之「投資營運計畫書」予甲方。甲方得以書面通知乙方於期限內檢具具體事證及說明（如具公信力之第三單位之產業報告或調查）向甲方專案報告。乙方逾期未提出相關說明者，視為違反本契約之約定，經甲方認定情節重大者，得終止本契約。

三、 租賃標的上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記應以乙方為名義，但經甲方書面同意者，不在此限。

四、 乙方不得將申租之土地、興建之建築物及設施之全部或一部移轉、出租、出借或以其他方式供他人使用，但經甲方書面同意者，不在此限；惟乙方如以此牟取不當利益，甲方得解除本契約並追討其所得。

五、 乙方應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得工廠登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於租賃標的面積之30%，且工廠登記之廠房面積不得低於租賃標的面積之20%，乙方符合前述標準者始符合完成使用之規定。乙方倘屬依法無需申請工廠登記者，應於土地點交之次日起3年內，依照核定計畫建廠完成並取得商業或營業登記，其建築物使用執照所載建蔽率不得低於租賃標的面積之30%，始符合完成使用之規定。

六、 乙方未依前項規定期限完成使用者，其完成使用保證金不予退還，解繳高雄市產業園區開發管理基金，甲方並得終止本契約。

第6條　設廠規定

乙方設廠時，應切實依本契約附件之相關規定辦理，惟其他法規如有規定者，乙方亦應遵守，不得違反，否則即屬違約。

第7條　維護費

乙方應依產業創新條例第53條規定繳交下列各款維護費用或使用費用：

一、 一般公共設施維護費。

二、 污水處理系統使用費。

三、 其他特定設施之使用費或維護費。

第8條　工作安全

乙方應於施工期間在工地設置安全設施，設置方式和地點應按勞工安全衛生法辦理。因工作安全或其設施所致之任何損害、糾紛概由乙方自行負責一切民、刑事及相關責任，與甲方無涉。

第 9 條　契約終止及違約責任

一、 乙方如有下列情事之一，經甲方通知限期改善，屆期未改善者，甲方得終止本契約：

(一) 違反本契約或其附件規定者。
(二) 以承租土地供違反法令之使用者。
(三) 自土地點交之次日起三年內未完成使用者。
(四) 未經甲方同意，承租土地上興建建築物請領建築執照及申請工廠登記未以乙方為名義者。
(五) 未經甲方同意，乙方將土地、建築物及設施之全部或一部移轉、出租、出借或以其他方式供他人使用。
(六) 未依法繳交產業創新條例第 53 條之各項維護費或使用費者。
(七) 違反土壤及地下水污染整治法或相關環保法令，致土地遭污染者。

二、 乙方如欲提前終止本契約，應於終止契約日前 3 個月前以書面通知甲方。

三、 乙方因違反本契約或其附件規定致甲方受有損害時，應依法賠償甲方所受之一切損害。

第 10 條　地上物之處理

一、 乙方於租期屆滿前終止本契約、或經甲方終止本契約、或租期屆滿不再續約者，除甲、乙雙方另有約定外，應於本契約終止或租期屆滿日返還租賃標的，並應回復土地原狀。

二、 契約終止前，乙方可向甲方申請協商，可依個案情況輔導乙方與其他廠商進行有償或無償處分地上物所有權，以活化承租土地之利用。乙方經輔導仍無法活化土地利用者，應回復土地原狀。

第 11 條　轉讓、合併及其他之限制

本契約為甲乙雙方專屬享有及行使，在本契約之有效期間，乙方不得將本契約轉讓、贈與、分割或為其他方式之處分。但經甲方書面同意者，不在此限。

第 12 條　繼受

本契約對於訂約雙方當事人及其繼受人均有相同拘束力。

第 13 條　通知

一、 依本契約規定應給予對方之任何通知或文件均應以書面為之，並應送達對方於本契約所載之地址。

二、 若甲乙雙方地址變更，應於變更地址後 7 日內以書面通知對方。

三、 如甲方無法送達或乙方拒收時，雙方同意以第 1 次書面投郵日期為合法送達日；如無法送達催告終止契約時，本契約視為終止。

第 14 條　契約之修正

本契約之修正經雙方同意後，應以書面為之。

第 15 條　不可抗力

本契約存續期間如發生天災、戰爭等不可抗力情事或其他不可歸責於雙方之事由，致乙方未能繼續依核定計畫執行者，得經雙方同意後修改契約內容或終止本契約。

第 16 條　適用法律及紛爭解決

本契約之準據法為中華民國法律。就本契約所生之爭議，而致發生訴訟時，雙方同意以臺灣高雄地方法院為第一審管轄法院。

第 17 條　契約份數

本契約正本一式二份，由甲、乙雙方各執一份為憑；副本 7 份，甲方執 6 份，乙方執 1 份。

第 18 條　附則

本契約若有未盡事宜，悉依產業創新條例暨其施行細則、產業園區土地建築物及設施使用收益及處分辦法、高雄市仁武產業園區產業用地(一)土地出租要點及其他相關法令規定辦理。

第 19 條　附件

一、土地標示及面積清冊。

二、租賃標的位置圖。

三、租賃標的審查同意函。

四、仁武產業園區產業用地（一）土地出租使用要點。

五、○○公司仁武產業園區產業用地(一)土地出租使用申請書件。

六、完成使用保證金繳交單據影本。

本頁為簽署頁

立契約人（甲方）：高雄市政府

法定代理人：陳其邁

代理機關 ：高雄市政府經濟發展局

法定代理人：廖泰翔

地 址：

立契約人（乙方）：

法定代理人 ：

地 址 ：

中　華　民　國　○　○　○　年　○　○　月　○　○　日

肆、仁武產業園區土地使用分區管制要點

為促進高雄市仁武產業園區土地利用的合理性與效率性，並塑造園區環境風格，使整體規劃符合公共安全、環境衛生與發展寧適性等目標。據此，對本園區土地及建築物之使用，按「產業創新條例」、「都市計畫法」第 22 條及同法高雄市施行細則，訂定土地使用分區管制要點：

第一點 本要點依據都市計畫法第 22 條及同法高雄市施行細則訂定之。

第二點 本園區內土地及建築之使用管制，依本要點規定辦理，本要點未規定者，依產業創新條例及其他相關法令辦理。

第三點 本園區內土地使用依產業創新條例劃設為下列分區及用地：

一、產業專用區：

（一）產業專用區（產 1）。

（二）產業專用區（產 2）。

二、公共設施用地。

三、其他經中央主管機關核定之用地。

第四點 產業專用區（產 1）係供與工業生產直接或相關之下列各行業使用：

一、製造業，其容許使用之產業類別細分為：

（一）金屬製品製造業（不含金屬表面處理業）。

（二）機械設備製造業。

（三）電力設備及配備製造業（不含放射性工業、電池製造業與專門表面處理之行業）。

（四）汽車零件製造業。

（五）其他運輸工具及其零件製造業。

（六）電腦、電子產品及光學製品製造業。

（七）食品及飼品製造業。

（八）塑膠製品製造業。

（九）家具製造業。

（十）經本府工業主管機關核定之低污染製造業。

二、與工業生產相關之行業，包括以下：

（一）電力及燃氣供應業。

（二）批發業（不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業）。

（三）倉儲業（含儲配運輸物流）。

（四）資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。

（五）企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。

（六）污染整治業。

（七）洗衣業（具中央工廠性質）。

（八）經本府工業主管機關核准安置之既有行業。

第五點 產業專用區（產1）得併供下列附屬設施使用：

一、辦公室。

二、倉庫。

三、生產實驗及訓練房舍。

四、環境保護設施。

五、單身員工宿舍。

六、員工餐廳。

七、從事觀光工廠或文化創意產業之相關設施。

第六點 產業專用區（產2）係配合產業發展政策及整體營運需要，提供下列支援產業使用：

一、住宿及餐飲業。

二、金融及保險業。

三、機電、管道及其他建築設備安裝業。

四、汽車客、貨運業、運輸補助業、郵政及快遞業。

五、電信業。

六、第四點第一項以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。

七、其他教育服務業。

八、醫療保健服務業。

九、創作及藝術表演業。

十、連鎖便利商店。

十一、其他經中央主管機關核准之行業。

第一項供支援產業使用之土地，於符合建築、消防及其他安全法規規範要件下，得與第四點第一項所列行業於同一建築物內混合使用，但其所占樓地板面積，不得超過該建築物總樓地板面積百分之三十。

第七點 管理服務用地係供園區管理機構行政、金融、商務、會議、展示、研討、餐飲、購物、防救災等多功能使用為主，其容許使用項目：

一、行政機關。

二、金融、保險分支機構。

三、產品展示陳列設施。

四、會議設施、集會堂。

五、職業訓練教育設施。

六、創業輔導設施。

七、安全、衛生、福利、醫療設施。

八、通訊設施與機構。

九、公用事業設施。

十、招待所、員工活動中心。

十一、轉運設施、停車場。

十二、餐飲業。

十三、警察消防機構。

十四、其他經中央主管機關核准之服務設施。

第八點 其他公共設施用地之容許使用項目如下：

一、公園兼滯洪池用地：供綠化景觀設施、水土保持設施、防洪設施、滯洪池、生態保育設施等使用。

二、綠地用地（綠地兼供道路使用）：以綠化使用為主，並得為防風林、景觀綠帶、隔離綠帶、隔離綠帶兼供道路及其他不妨害綠地功能且經本園區管理機構同意設置之設施使用。

三、供水設施用地：供自來水事業設施及其附屬設施使用。

四、電力設施用地：供電力事業、輸配電鐵塔及其附屬設施使用。

五、環保設施用地：供污水處理設施、廢棄物收集設施與環境監測及其附屬設施使用。

六、停車場用地：供興建平面、立體停車場、相關交通服務設施及其附屬設施使用。

七、道路用地：供道路、管制哨及相關道路附屬設施使用。

第九點 法定建蔽率及容積率上限規定如下：

使用分區/用地			建蔽率（%）	容積率（%）
土地使用分區	產業專用區（產1）		60	210
	產業專用區（產2）		60	300
公共設施用地	管理服務用地		60	250
	供水設施用地		60	250
	電力設施用地		60	250
	環保設施用地		60	250
	停車場用地	平面	10	20
		立體	80	240
	公園用地		15	30
	公園兼滯洪池用地		15	30

為因應廠商進駐設廠之需求，提高土地使用彈性，產業專用區（產1）容積管制規定如下：

一、產業專用區（產1）容積率不得超過210%，惟申請建築時，產業園區目的事業主管機關得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過300%。

二、目的事業主管機關應進行本計畫範圍內產業專用區（產1）總容積管制，即產業專用區（產1）總容積不得超過1,093,469平方公尺。

第十點　本園區內建築基地不得適用建築技術規則及其他有關容積獎勵相關法規之規定。

第十一點 本園區內停車場用地之規劃與設計原則：

一、停車場週邊（含退縮地）應設置寬度2公尺以上之綠地，並以遮蔭大型喬木及1.5公尺以上綠籬適當分隔停車空間。

二、每處停車場之聯外出入口不得超過兩個。

三、每三個停車位至少種植一株遮蔭喬木，每十個併排汽車停車位間須設置栽植槽。

第十二點 本園區內建築基地之附設停車空間應依建築技術規則辦理。

第十三點 本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

使用分區	應附設裝卸位數
產業專用區（產1）	1. 每一基地至少需附設一裝卸位。 2. 總樓地板面積未達1,500平方公尺者，因實際特殊需求或原因及提出相關配套措施，經本園區管理機構同意者，得予免設。
產業專用區（產2）	樓地板面積在500平方公尺（含）以上至3,000平方公尺（含）者，應附設一裝卸位，總樓地板面積3,000平方公尺以上者，每超過3,000

	平方公尺或其零數應增設一裝卸位。

說明：1. 每一裝卸位寬度不得小於 4 公尺、長度不得少於 13 公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2 公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。

2. 裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。

3. 貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。

4. 基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。

第十四點 本園區產業專用區建築退縮原則：

一、臨 25 公尺（含）以上道路之建築線退縮深度為 8 公尺；面臨 25 公尺以下之道路，應自道路境界線退縮 6 公尺。基地位於道路交角處其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線；非臨道路側，應自基地境界線退縮 3 公尺，詳下圖。建築基地之退縮部分，除另有規定外，應於臨道路側設置無遮簷人行步道，並連接該道路人行步道，以構成完整步道系統，其設置淨寬至少 1.5 公尺，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯。

二、退縮地應植栽綠化，不得設置圍籬，並與人行道合併或與園區整體景觀綠地系統配合；退縮地除經產業園區管理機構核准可為出入口外，不得作為車道、停車場或放置未經核准的雜項工作物。

三、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備，應予以遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。

第十五點 本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。

第十六點 本園區建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於 250 公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過 4 公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

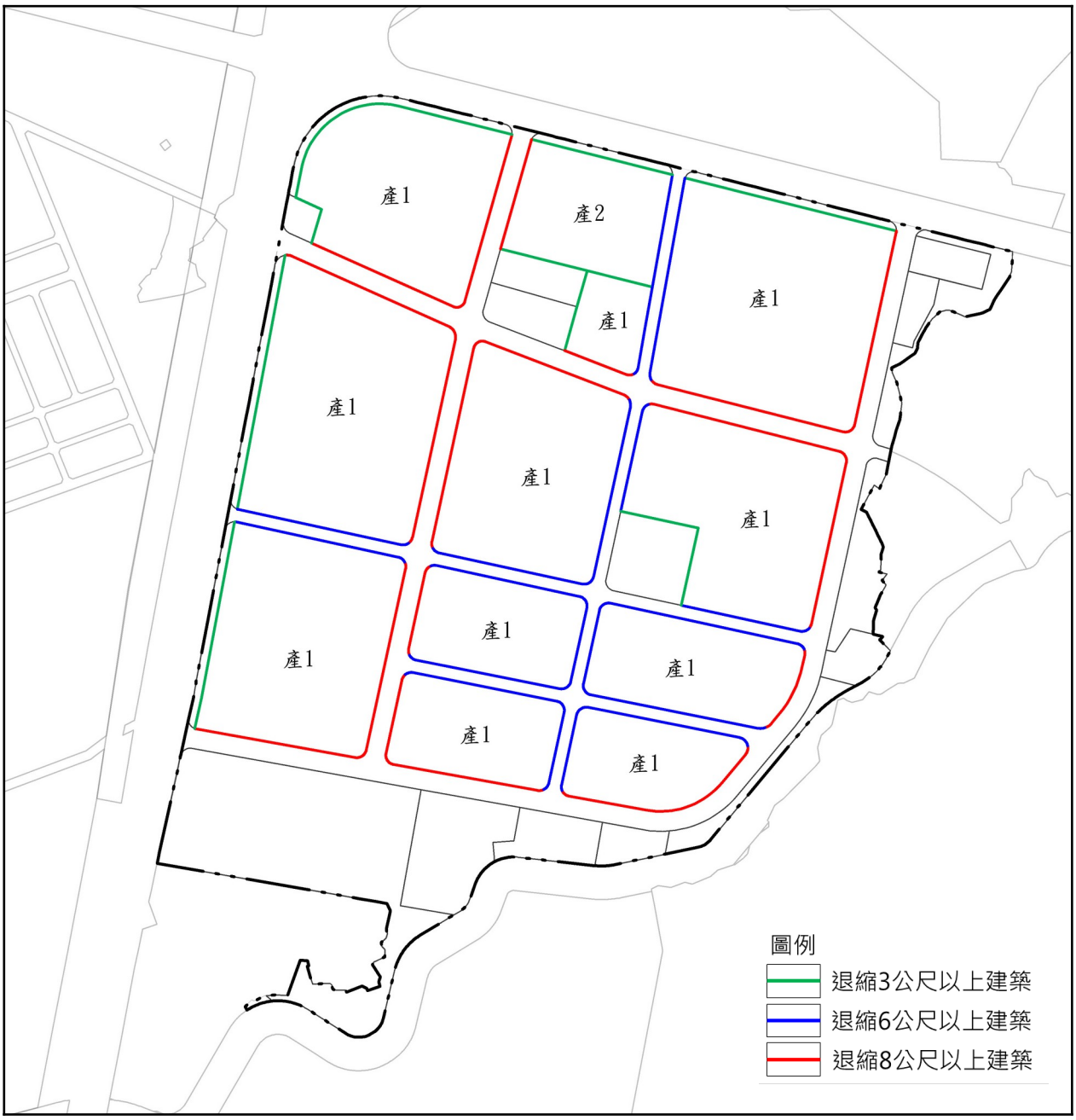
惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十七點 建築量體、型態管制及建築附屬物設計原則：

一、屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

二、建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。

三、本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用未經處理之金屬浪板、石綿瓦、塑膠浪板、其他具公害或易燃性材料。



產業專用區建築退縮示意圖

第十八點 本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

（一）應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少 1.5 公尺。

（二）標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（三）標示物之立面面積不得超過 8 平方公尺，垂直高度不得超過 2.5 公尺。

二、建築物壁面標示物

（一）僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（二）每棟建築物之單一鄰街立面得設置一處牆面標示物；每一基地之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過 200 公尺以上，每 200 公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

（三）牆面標示物面積以不得超過 4.5 平方公尺，字高不得超過 1.2 公尺，且不得突出於牆面。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十九點　植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十點　沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二十一點 本園區內公共設施及公用設備用地，如擬依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法作多目標使用時，以供作非營業性之公共使用者為限。

伍、仁武產業園區產業用地(一)容積總量管制執行要點

一、 高雄市政府經濟發展局（以下簡稱本府經發局）為執行「擬定澄清湖特定區計畫（配合高雄市仁武產業園區）細部計畫案」產業用地(一)之容積總量管制，特訂定本要點。

二、 本要點由仁武產業園區（以下簡稱本園區）服務中心受理審查，並提請本府經發局核發容積增量許可函。惟於開發期間，服務中心未成立前，由本府經發局統籌。

三、 本園區內產業用地(一)之建築基地申請開發者（以下簡稱申請人），其平均投資金額（不含土地價款）超過本園區單位面積之平均投資金額（每公頃2億元）者，始得依本要點規定申請建築容積增量。

四、 產業用地(一)容積率不得超過210%，惟申請建築時，本府經發局得視設廠性質及需求酌予增加容積率，增加後容積率不得超過300%。

五、 申請人得依下列各款方式，申請增加容積率，其容積獎勵項目及建築容積獎勵額度依下列公式核計，並依附表規定辦理：

△F ≦ △F1+△F2+△F3+△F4+△F5

△F：建築物申請容積增量得增加之容積率總和，最高不得超過90%。

△F1：增設汽車停車空間，得增加之容積率，最高不得超過10%。

△F2：增設機車停車空間，得增加之容積率，最高不得超過5%。

△F3：設置屋頂或外牆面綠化設施，得增加之容積率，最高不得超過10%。

△F4：新增投資金額，得增加之容積率。

△F5：於本市設置研發中心或營運總部，得增加之容積率，△F5=15%。

六、 申請人以ΔF4申請建築容積增量者，應依回饋負擔規定於容積利益實現時（以建築物取得使用執照為認定時點）向本府經發局繳納回饋金。回饋金繳納依下列公式計算：

T＝每月應繳納之回饋金＝A×ΔF4÷F×R

A＝申請基地面積 (m^2)

ΔF4＝新增投資金額，得增加之容積率

F＝產業用地(一)原得申請之容積率 (210%)

R＝本園區一般公共設施維護費，本府公告前暫以4元/m^2/月（13.2元/坪/月）標準計收，俟本府公告後，則依公告之費率計收。

七、 回饋金原則採取每年繳納一次方式，繳納年數為35年（建築使用年限依財政部高雄市國稅局固定資產耐用年數表，鋼筋(骨)混凝土建造之工

廠用廠房耐用年限為35年），惟倘使用時間超過建物使用年限時，回饋金仍應繼續繳納。

八、 申請人依本要點申請增加容積時，應檢具計畫書圖（含配置圖、各層平面圖、面積計算、容積檢討、建築物高度及停車位檢討）向本園區服務中心申請。申請依ΔF4增加容積者，應再檢具投資計畫書；申請依ΔF5者，應再檢具經濟部工業局核發之研發中心核定函或營運總部認定函。

九、 本府經發局得要求申請人每年提送相關證明文件，以供檢核是否達到容積增量認定標準，若於建築物使用期間未達申請容積增量時所承諾之目標，該新增樓地板面積視同閒置未利用，依行政院核定之「產業用地政策革新方案」指導，應加倍課徵回饋金，以利促進地用。

十、 建物於回饋金繳納期間因故滅失，經本府經發局認定屬實者，則停止繳納回饋金。

十一、 建物如有增、改建之情形者，應依本要點規定重新辦理，按新申請之容積增減量，計算應繳納之回饋金。屬增建部分，該部分應重新起算繳納年數35年；屬減建部分，該部分已繳納之回饋金不予退還。

十二、 建物如拆除重建者，應依本要點規定重新辦理，按重建時申請之容積增量，計算應繳納之回饋金。

十三、 本園區產業用地(一)總容積不得超過1,091,669平方公尺。當容積總量全部使用後，本要點即停止適用。

十四、 本園區產業用地(一)容積總量使用情形，由本府經發局定期公告。

附表　仁武產業園區產業用地(一)建築容積獎勵項目及額度表

項目	認定標準
△F1	1.滿足法定汽車停車位後，另提供之汽車停車空間，應集中設置。 2. △F1＝1% × N1 × M N1：增設汽車停車位數量 M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m^2)
△F2	1.滿足法定機車停車位後，另提供之機車停車空間，應集中設置。 2. △F2＝0.2% × N2 × M N2：增設機車停車位數量 M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m^2)
△F3	1.滿足「高雄市綠建築自治條例」建築物屋頂設置太陽光電發電設施之規定後，另設置屋頂或外牆面綠化設施，綠化設施指種植地被、花草、灌木或蔓藤類植物，並直接固著或以盆器固著於建築物屋頂或外牆上。地被及花草之覆土深度需 30 公分以上，灌木及蔓藤類之覆土深度需 60 公分以上。 2. △F3＝0.01% × N3 × M N3：設置屋頂或外牆面綠化設施面積(m^2) M：基地係數，M=2500/建築基地面積(m^2)
△F4	1.超過本園區單位面積之平均投資金額（每公頃 2 億元），每再增加投資 1 千萬元者，得增加容積率 1%。 2. △F4＝[(T 萬 － A × 2 萬) / 1000 萬] ×1% T＝總投資金額（不含土地價款）(萬) A＝建築基地面積 (m^2)
△F5	經濟部工業局核發之研發中心核定函或營運總部認定函。

陸、仁武產業園區建築景觀預審規範

壹、總則

一、 為增進仁武產業園區(以下簡稱本園區)土地合理有效利用，符合公共安全及促進都市環境（自然環境、人文環境、實質環境）與建築群體及人為活動間之和諧關係，特訂定仁武產業園區建築景觀預審規範(以下簡稱本規範)。

二、 本園區各建築基地之開放空間及景觀設計應依本規範之規定辦理，本規範未規定者，則應配合相關法令規定辦理。

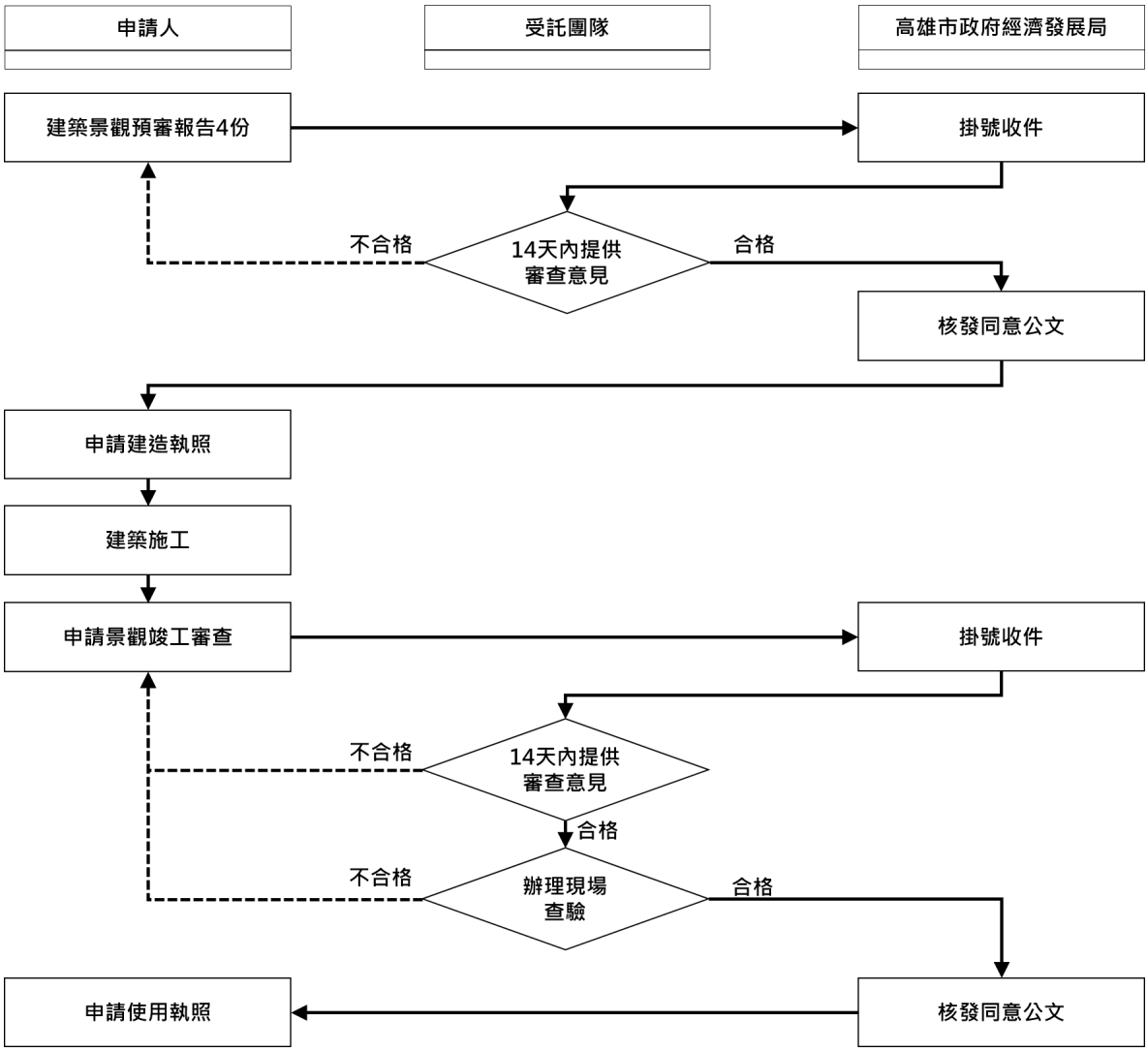
三、 本規範由仁武產業園區服務中心(以下簡稱服務中心)負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託審查單位(開源營造股份有限公司)代為執行。

四、 本規範係配合擬定澄清湖特定區計畫（配合高雄市仁武產業園區）細部計畫案辦理。

貳、申請程序與審議流程

一、 起造人申請建築相關執照前，應依本規範及建築相關法令，向服務中心申請預先審核，必要時得召開審查會議，並請起造人與設計人到場說明。

二、 仁武產業園區建築景觀預審作業程序



註：本規範由服務中心負責受理及審查，然本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託審查單位(開源營造股份有限公司)代為執行，惟同意公文仍應由本府經發局核發。

三、 申請人取得建造執照後，如需辦理變更設計，應依前點建築景觀預審作業程序辦理；但變更內容符合「高雄市都市設計審議許可案件變更設計作業要點」第5點及第6點者，由申請人逕向本府工務局申請，並應主動函知本府經發局備查，以作為完工後景觀查驗之依據。

四、 申請人於工程完工後，應向本府申請景觀查驗，併同本園區出租/售要點所述變更或破壞已完工之公共設施一併查驗，通過後始得申請使用執照。

參、建築景觀預審規範

第一部分：細部計畫土地使用分區管制要點

第十三點　本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：

使用分區	應附設裝卸位數
產業專用區（產1）	1. 每一基地至少需附設一裝卸位。 2. 總樓地板面積未達 1,500 平方公尺者，因實際特殊需求或原因及提出相關配套措施，經本園區管理機構同意者，得予免設。
產業專用區（產2）	樓地板面積在 500 平方公尺（含）以上至 3,000 平方公尺（含）者，應附設一裝卸位，總樓地板面積 3,000 平方公尺以上者，每超過 3,000 平方公尺或其零數應增設一裝卸位。

說明：1.每一裝卸位寬度不得小於 4 公尺、長度不得少於 13 公尺，有頂蓋者其高度不得小於 4.2 公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。

2.裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。

3.貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。

4.基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。

第十四點　本園區產業專用區建築退縮原則：

一、臨 25 公尺（含）以上道路之建築線退縮深度為 8 公尺；面臨 25 公尺以下之道路，應自道路境界線退縮 6 公尺。基地位於道路交角處其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線；非臨道路側，應自基地境界線退縮 3 公尺。建築基地之退縮部分，除另有規定外，應於臨道路側設置無遮簷人行步道，並連接該道路人行步道，以構成完整步道系統，其設置淨寬至少 1.5 公尺，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯。

二、退縮地應植栽綠化，不得設置圍籬，並與人行道合併或與園區整體景觀綠地系統配合；退縮地除經產業園區管理機構核准可為出入口外，不得作為車道、停車場或放置未經核准的雜項工作物。

三、退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備，應予以遮蔽並加以綠化植栽處理，且須符合各公共設備事業單位之規定。

第十五點　本園區之建築基地不分規模應予綠化，檢討計算依建築基地綠化設計技術規範辦理。其建築物均應依高雄市綠建築自治條例之規定辦理。

第十六點　本園區建築如設置圍牆者，應符合下列規定：

一、沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於 180 公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；

其他圍牆高度不得高於250公分。

二、供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過4公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十七點　建築量體、型態管制及建築附屬物設計原則：

一、屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽。

二、建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽。

三、本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用未經處理之金屬浪板、石綿瓦、塑膠浪板、其他具公害或易燃性材料。

第十八點　本園區指標設施之設置應依下列原則辦理：

一、基地出入口標示物

（一）應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少1.5公尺。

（二）標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（三）標示物之立面面積不得超過8平方公尺，垂直高度不得超過2.5公尺。

二、建築物壁面標示物

（一）僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌。

（二）每棟建築物之單一鄰街立面得設置一處牆面標示物；每一基地之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過200公尺以上，每200公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制。

（三）牆面標示物面積以不得超過4.5平方公尺，字高不得超過1.2公尺，且不得突出於牆面。

惟視基地開發需求，經本園區管理機構同意者，不在此限。

第十九點　植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口。

第二十點　沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調。

第二部分、其他規定事項

一、法定空地應留設二分之一以上綠化植栽，綠覆率應達70%以上；有關綠覆率、綠覆面積之計算基準悉依「高雄市都市設計審議原則」辦理。

二、 突出於地面層之通風口、台電配電場所宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化。基地面積大於2400平方公尺者，台電配電場所不得設置於退縮帶。

三、 本園區建築物應依「高雄市綠建築自治條例」設置太陽能光電發電設施。

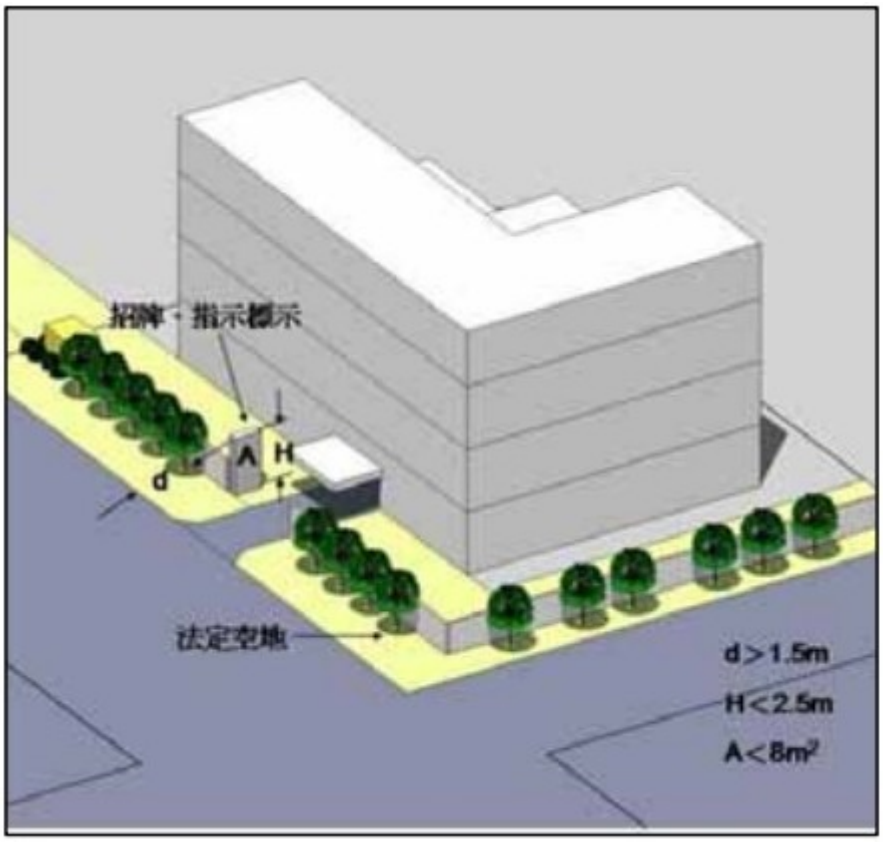
四、 本園區廠商產業用水回收率應達58%以上。

五、 各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每50平方公尺各至少栽種2棵計，少於10棵者以10棵計，餘數不滿50平方公尺者以2棵計。喬木應掛設樹名牌，樹距不得低於4公尺。

六、 各建築基地綠化植栽之選用，應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量80%以上，並應自行負擔移植相關費用。移植喬木存活率未達80%以上者，配合環評承諾應死1補2，本園區服務中心未來將定期查核。

七、 建築基地內之喬木及灌木，除園區內既有留存移植之樹木外，不得種植外來種，應選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物。

八、 土地使用分區管制要點第18點所述基地出入口標示物示意如下圖。



基地出入口標示物示意圖

第三部分、綠地用地(兼供道路使用)設置車輛出入口

面臨澄觀路及水管路之建築基地，該道路沿線屬綠地用地(兼供道路使用)(以下簡稱綠兼道)，原則不設置車輛出入口，惟因基地開發需求，符合下列規定並經管理機構同意者，得設置車輛出入口。

一、 建築基地臨接綠兼道，位於計畫道路交叉口 30 公尺範圍內，不得設置汽機車出入口。

二、 建築基地臨接本園區計畫道路者，於綠兼道側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置大型車輛出入口。

三、 接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於 40 公尺；建築基地相鄰之建築基地如並無臨接本園區計畫道路，汽機車出入口與建築基地地界線之距離不得小於 20 公尺；其餘汽機車出入口與建築基地地界線之距離不得小於 10 公尺。

四、 汽機車出入口應有緩衝空間，自建築線後退 3 公尺之汽機車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各 60 度以上範圍無礙視線。

五、 建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果為準，應依審議決議及核備圖說辦理。

肆、建築景觀預審需檢附文件

一、 本園區之建築景觀預審申請應具備景觀管制要點審查申請書(附件一)、建築景觀預審自行檢核表(附件二)、建築景觀預審計畫書圖應載明內容自行檢核表(附件三)、建築景觀預審計畫書圖，裝訂成 A3 格式，一式四份，送服務中心辦理審查作業。

二、 建築景觀預審計畫書圖應載明事項：

（一）簡述建築內容、設計目標及構想。

（二）基地位置圖：載明基地位置、地號及道路名稱。圖面及文字應清晰。

（三）基地現況與周邊環境概述：配合圖文或照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於一千分之一，且至少包含鄰近基地界線二十公尺範圍。

（四）基地配置圖：載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於一千分之一。

（五）景觀配置圖：基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於一千分之一。

（六）基地其他設施圖：載明基地需設置太陽能設施、產業用水回收設施、水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於五百分之一。

（七）建築設計圖：載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於一千分之一。

附件一　仁武產業園區建築景觀預審規範審查申請書

編號	（服務中心填寫）	
備案日期文號	年　月　日　字第　號（服務中心填寫）	
案名		
基地地址		
起造人	姓名(名稱)	（簽章）
	地址	
	身分證或營利事業統一編號	
	出生年月日	
	電話	
	傳真	
	電子郵件	
設計人	姓名(名稱)	（簽章）
	地址	
	營利事業統一編號	
	執開業證書字號	
	電話	
	傳真	
	電子郵件	

附件二　仁武產業園區建築景觀預審規範自行檢核表

<table>
<tr><th rowspan="2">點次</th><th rowspan="2">規定內容</th><th rowspan="2">檢討內容</th><th colspan="2">檢討結果</th><th rowspan="2">說明頁碼</th></tr>
<tr><th>符合</th><th>未符合</th></tr>
<tr><td colspan="6">第一部分、細部計畫土地使用分區管制要點</td></tr>
<tr><td>第十三點</td><td>本園區貨物裝卸位設置數量應按下表規定辦理：
<table>
<tr><th>使用分區</th><th>應附設裝卸位數</th></tr>
<tr><td>產業專用區（產1）</td><td>1. 每一基地至少需附設一裝卸位。
2. 總樓地板面積未達1,500平方公尺者，因實際特殊需求或原因及提出相關配套措施，經本園區管理機構同意者，得予免設。</td></tr>
<tr><td>產業專用區（產2）</td><td>樓地板面積在500平方公尺（含）以上至3,000平方公尺（含）者，應附設一裝卸位，總樓地板面積3,000平方公尺以上者，每超過3,000平方公尺或其零數應增設一裝卸位。</td></tr>
</table>
說明：1.每一裝卸位寬度不得小於4公尺、長度不得少於13公尺，有頂蓋者其高度不得小於4.2公尺，但若須使用貨櫃車裝卸者，應依實際所需規模設置。
2.裝卸位應設置在同一建築基地內，同一幢建築物內供二類以上用途使用者，設置標準分別計算附設。
3.貨物裝卸位及堆積場應避免直接曝露於道路及永久性開放空間之公共視野內，且須以建築物或適當設施或植栽作有效遮擋。
4.基地裝卸位及堆積場不得佔用退縮地。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">第十四點</td><td>臨25公尺（含）以上道路之建築線退縮深度為8公尺；面臨25公尺以下之道路，應自道路境界線退縮6公尺；非臨道路側，應自基地境界線退縮3公尺</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基地位於道路交角處其退縮線應自兩退縮線交叉點再各自退縮最短邊規定深度位置連線為其退縮線</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>建築基地之退縮部分，除另有規定外，應於臨道路側設置無遮簷人行步道，並連接該道路人行步道，以構成完整步道系統，其設置淨寬至少1.5公尺，並以鋪設透水性鋪面為原則，且應與相鄰基地所設置之人行步道順平相接，並不得設置階梯</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>退縮地應植栽綠化，不得設置圍籬，並與人行道合併或與園區整體景觀綠地系統配合；退縮地除經產業園區管理機構核准可為出入口外，不得作為車道、停車場或放置未經核准的雜項工作物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>退縮地得埋設公共管線，且以地下化為原則，並應避免破壞退縮地之完整性；若必需設置於地面上之設備，應予以遮蔽並加以綠化植栽處</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

點次	規定內容		檢討內容	檢討結果		說明頁碼
				符合	未符合	
	理，且須符合各公共設備事業單位之規定					
第十六點	本園區建築如設置圍牆者，應符合下列規定：	沿街面之圍牆應採透視性設計或設置綠籬，其圍牆高度自基地地面不得高於180公分，且牆面視覺可穿透比率需達百分之五十以上；其他圍牆高度不得高於250公分				
		供汽車或人行進出之出入口圍牆高度以地面層樓高，且以不超過4公尺為限，該部分得免檢討視覺可穿透比率				
第十七點	建築量體、型態管制及建築附屬物設計原則：	屋頂突出物應配合建築物造型作整體設計或遮蔽				
		建築物臨街立面之附屬設備（冷氣機、水塔、廢氣排出口等）應配合建築物立面整體設計或遮蔽				
		本園區內建築物應依建築技術規則建築設計施工篇第三百二十一條至第三百二十三條（綠建材）之規定辦理，且立面材料不得使用未經處理之金屬浪板、石綿瓦、塑膠浪板、其他具公害或易燃性材料				
第十八點	基地出入口標示物	應設置於廠址使用之道路側，並擇主要出入口旁退縮地範圍，距建築線至少1.5公尺				
		標示物只限於標示地址、聯絡方式、建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌				
		標示物之立面面積不得超過8平方公尺，垂直高度不得超過2.5公尺				
	建築物壁面標示物	僅限標示建築物名稱、公司機構名稱及企業標誌				
		每棟建築物之單一鄰街立面得設置一處牆面標示物；每一基地之牆面標示物最多設二處，且不得在屋頂突出物上出現；但建築物之單一鄰街立面長度超過200公尺以上，每200公尺可增設牆面標示物一處，標示物數量不受前述規定限制				
		牆面標示物面積以不得超過4.5平方公尺，字高不得超過1.2公尺，且不得突出於牆面				
第十	植栽綠化應包含喬木、灌木草花及地被等植栽，且植栽不得遮蔽或妨礙各項標誌、燈號等系統、公共人行通道及車輛出入口					

點次	規定內容	檢討內容	檢討結果		說明頁碼
			符合	未符合	
九點					
第二十點	沿街面種植之喬木應選用深根性、枝幹強韌、根系垂直之樹種，且配合相鄰基地沿街面喬木樹種，維持街道景觀協調				
第二部分、其他規定事項					
一	法定空地應留設二分之一以上綠化植栽，綠覆率應達70%以上；有關綠覆率、綠覆面積之計算基準悉依「高雄市都市設計審議原則」辦理。				
二	突出於地面層之通風口、台電配電場所宜避開主要開放空間設置，並予以美化遮掩與綠化。基地面積大於2400平方公尺者，台電配電場所不得設置於退縮帶				
三	本園區建築物應依「高雄市綠建築自治條例」設置太陽能光電發電設施				
四	本園區廠商產業用水回收率應達58%以上				
五	各建築基地綠化面積之喬木植樹量，以每50平方公尺各至少栽種2棵計，少於10棵者以10棵計，餘數不滿50平方公尺者以2棵計。喬木應掛設樹名牌，樹距不得低於4公尺	法定喬木植數量：　　棵 實際喬木植數量：　　棵			
六	各建築基地綠化植栽之選用，應配合環評承諾以園區內既有喬木移植為優先，其移植數量應佔基地喬木植樹量80%以上，並應自行負擔移植相關費用。移植喬木存活率未達80%以上者，配合環評承諾應死1補2，本園區服務中心未來將定期查核	採用園區既有喬木移植數目：　　棵			
七	建築基地內之喬木及灌木，除園區內既有留存移植之樹木外，不得種植外來種，應選擇具有綠化、季節變化特性及容易維護之植物				
第三部分、綠地用地(兼供道路使用)設置車輛出入口(申請於綠地用地(兼供道路使用)開口者始需填寫)					
一	建築基地臨接綠兼道，位於計畫道路交叉口30公尺範圍內，不得設置汽機車出入口				
二	建築基地臨接本園區計畫道路者，於綠兼道側僅能設置一處汽機車出入口，且不得設置大型車輛出入口				
三	接鄰兩建築基地之汽機車出入口，其兩者距離不得小於40公尺；建築基地相鄰之建築基地如並無臨接本園區計畫道路，汽機車出入口與建築基地地界線之距離不得小於20公尺；其餘汽機車出入口與建築基地地界線之距離不得小於10公尺				
四	汽機車出入口應有緩衝空間，自建築線後退3公尺之汽機車出入路中心線上一點至道路中心線之垂直線左右各60度以上範圍無礙視線之空間				
五	建築基地開發計畫達本市建築物交通影響評估準則送審門檻者，以交通影響評估之審議結果				

點次	規定內容	檢討內容	檢討結果		說明頁碼
			符合	未符合	
	為準，應依審議決議及核備圖說辦理				

註：申請人應視申請案性質依表列檢討項目逐項檢討，併於「檢討內容」欄中簡要說明，無須檢討項目亦請敘明免檢討原因。

附件三　建築景觀預審計畫書應載明內容自行檢核表

檢討項目	建築景觀預審計畫書圖應載明內容	檢討結果		說明頁碼
		符合	未符合	
簡述	建築內容、設計目標及構想			
基地位置圖	載明基地位置、地號及道路名稱。圖面及文字應清晰			
基地現況與週邊環境概述	配合圖文及照片，載明建築基地地理條件、基地界線、退縮線、鄰接道路名稱與寬度。圖面比例尺不得小於一千分之一，且至少包含鄰近基地界線20公尺範圍			
基地配置圖	載明建築基地界線及申請建築物之位置、建築基地退縮空間、綠化範圍及面積比例。圖面比例尺不得小於一千分之一。			
景觀配置圖	基地開放空間及法定空地、景觀意象、植栽計畫(應含植栽構想、功能、灌溉系統之說明；原有植栽與新植栽之位置、數量計算及保存、移植與砍伐之說明；配合環評承諾優先移植本園區既有植栽之位置、數量計算及移植季節之處理方式之說明)。圖面比例尺不得小於一千分之一。			
基地其他設施圖	載明基地需設置太陽能設施、產業用水回收設施、水塔、儲液(氣)槽、冷卻塔、機房、垃圾相等設備，配置於地面之固定設施物、立面之附加物、屋頂之附加物及其遮蔽設施等之位置、平面、立面、剖面、細部大樣、材料、顏色及遮蔽設施之遮蔽效果。圖面比例尺不得小於二百分之一。			
建築設計圖	載明建築物平面、立面、剖面、構造、空間用途、外牆顏色及材質，並表達其與周圍景觀之配合關係。圖面比例尺不得小於一千分之一			
綠地用地(兼供道路使用)設置車輛出入口(申請於綠地用地(兼供道路使用)開口者始需填寫)	現況實測圖：載明鄰近道路狀況，圖面比例不得小於二百分之一，因園區開發初期尚未興闢道路，可改附道路樁位圖			
	現況照片及索引圖			
	汽機車出入口平面圖、剖面示意圖：需清楚表達臨計畫道路交叉口位置及鄰地關係，並標註距離，圖面比例不得小於二百分之一			
	相關證明文件及會勘公文：如經交通影響評估審議通過，應檢附審議決議及核備圖說			

柒、仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則

壹、資源或污染物總量管制審查處理流程圖

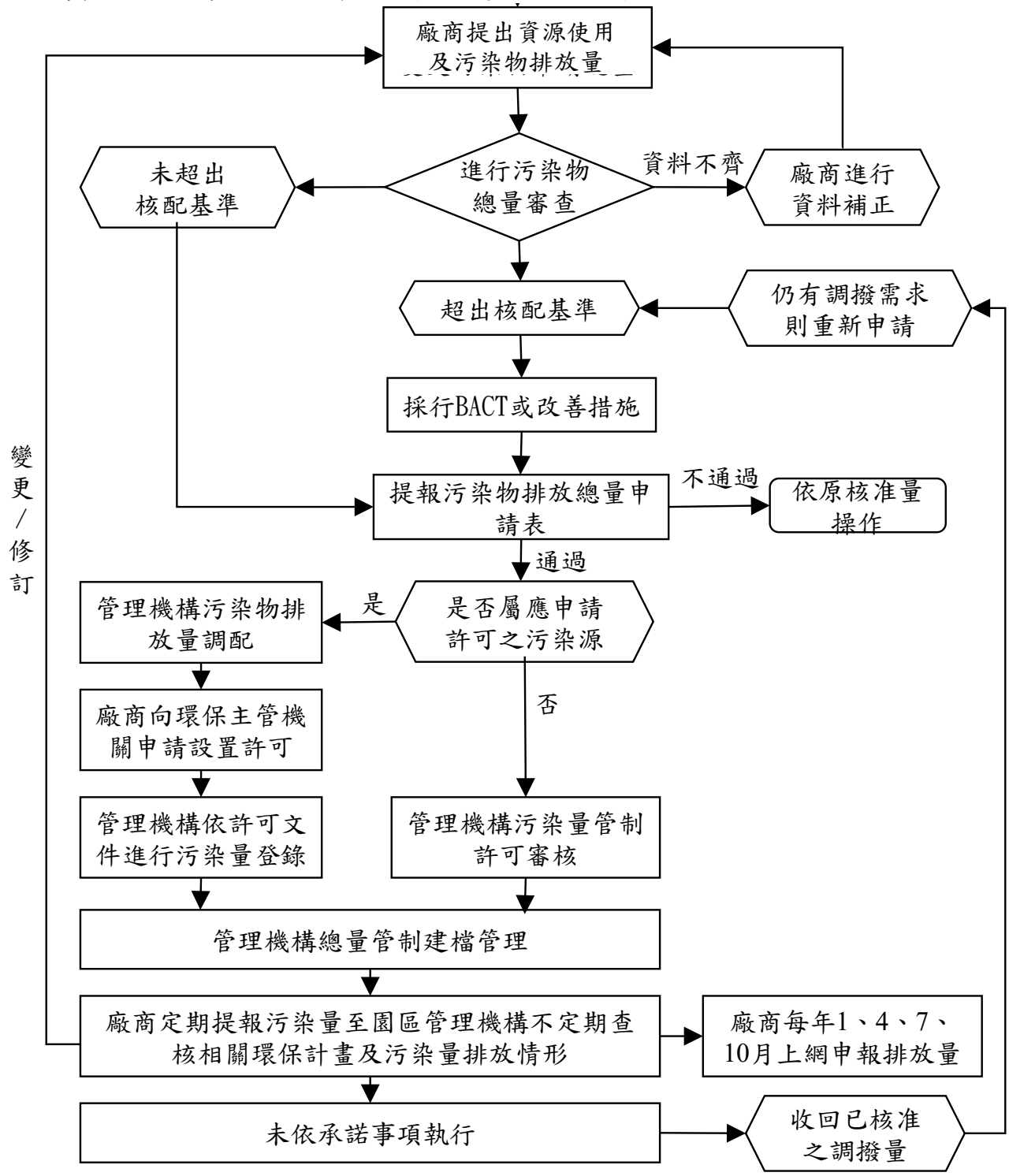


圖 1　仁武產業園區資源或污染物總量管制審查流程圖

貳、資源或污染物總量管制審查核發原則

(一)仁武產業園區（以下簡稱本園區）產業發展方向以低污染、低排放之產業為主導，並**以租/購地核配量做為篩選廠商進駐之條件，針對污染物排放量採分配方式，廠商並無所有權**。

(二)本園區廠商於申請入區時，應提出資源使用或污染排放量申請；變更資源使用及污染物排放量情形時，應提出變更；若園區總核配量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以租/購地面積比例等比例調整。廠商申請需檢具資源或污染物總量管制審查表（附件 1-1）及相關資料乙式 2 份，提送高雄市政府(以下簡稱本府)審查（廠商申請文件審查標準作業程序如附件 2），資源或污染物總量管制審查處理流程如圖 1。

1. 入區申請：本園區廠商於用地租售審查階段及或有企業併購情形時，皆需依入區申請程序申請總量。於用地租售審查階段申請資源或污染量者，得以用地租售手冊中申租文件之申請表格申請。以企業併購方式申請者，其設廠用地原核准資源或污染量不得沿用，需重新申請，惟若「企業併購」情形係併入園區內既有廠商，則由該既有廠商以變更申請方式提出，該設廠用地原核准資源或污染量仍不得沿用。
2. 變更申請：本園區廠商因產業類別變更、製程改變、產能增加等情形，造成原核配量不足，或展延環保許可，得提出資源或污染量變更申請。
3. 總核配量變動：園區資源或污染總量因環評變更有所變動時，本園區廠商之核配量皆需以租/購地面積等比例調整，不得有異議。

(三)資源或污染物總量管制精神為降低區域性環境污染，避免污染物過度集中，並藉由後續查核管理加強區內廠商對於污染物排放削減率與妥善管理污染排放量。

(四)調撥量申請及變更：

本園區廠商依「租/購地面積」核配資源或污染量，若核配量不足，

或因產業類別變更、製程改變、產能增加等因素，造成原核配量不足嚴重影響營運或其他特殊因素考量，得向本府申請調撥資源或污染物排放量，申請廠商應於調撥期間繳納環境回饋金，並簽訂調撥及減量切結書（附件3、4），後續仍需配合本府進行污染物核配量減量檢討或增加污染防制設備以提升防制效率。申請調撥應提送下列文件：

1. 廢氣排放量超過核配基準者應提出BACT(最佳可行控制技術)，若該製程非屬環保署公告需採行BACT(最佳可行控制技術)之製程，則應說明所採用控制技術較其他控制技術為佳之說明。
2. 廢(污)水質、量超過核配基準者，應提出廢(污)水管制計畫。
3. 廢棄物數量超過核配基準者，應提出廢棄物減量計畫。
4. 用電量或溫室氣體超過核配基準者，應提出用電減量計畫或溫室氣體抵減計畫(包括最佳可行技術BAT之採用方式與減量效益)，並需進行碳抵換，例如購買先期專案或抵換專案環保署審查核發之減量額度。

(五)調撥原則：

1. 各廠商於租/購地時已於租/購地申請書中提出各項資源或**污染量**申請，除配合本府整體政策經濟方針及重點產業引進，本府將不再進行園區資源或污染物總量提升之環評變更，廠商如有需申請調撥資源或污染物，每公頃投資金額在2億元以下者，各項資源或污染物調撥量以不得超出污染核配基準之20%為限，每公頃投資金額在2億元以上者，由本府依超出之比例並考量園區核配量使用情況核配之。惟園區總資源或污染量因環評變更有所變動時，各廠商之核配基準皆須依租/購地面積等比例調整，不得有異議。
2. 本園區廠商申請調撥資源使用或污染物排放量，為暫時性提供廠商維持正常營運，為達永續發展仍需請廠商採最佳可行性控制技術(BACT)或相關減量技術進行減量，本府後續將追蹤廠商進行查核管理作業，若廠商申請量大於實際排放量或未再繳環境回饋金，將收回調撥量。

3. 若近2年內遭陳情次數達3次以上之廠商（新租售廠商以舊廠認定，包含本府各局處之陳情次數），或認定有重大污染情形者不得申請污染物調撥量。
4. 有關環境回饋金執行經費計算公式及各項參數因子，為本府審核時之內部參考依據，後續將配合環境現況及法規規定隨時進行修正。
5. 本府同意之核配量僅為暫時核配量，未來將以環保單位核發許可文件之許可量做為許可核配量，用電則以廠商申請用電契約容量作為許可核配量，並據以計算各項環境回饋金。

(六)本園區資源或污染物總量管制調撥審查將以下項目進行綜合評估，並由服務中心及本府指定之審查單位進行初審，再由本府進行複審同意。

1. 廠商污染特性
2. 污染物種類與風險
3. 污染物排放量合理性
4. 廠商是否已採行BACT或相關減量技術進行減量(若屬環保署公告之「固定污染源最佳可行控制技術」所列製程，可依公告採行相關控制技術並敘明)
5. 未來改善作為及減量措施
6. 後續廠內管理
7. 民眾陳情次數
8. 環境回饋金計算表

資源或污染物調撥量為**暫時撥借，**無法依撥借量作為是否調撥之依據，並非可無限期進行調撥，故仍需視整體綜合考量，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，故廠商應自行考量未來污染物排放許可量可能不足之設廠風險，不得拒絕歸還污染調撥量。

(七)後續追蹤查核管理

1. 本園區廠商每年應於1、4、7、10月上網申報排放量，實際申報方式及頻率由服務中心另行通知。服務中心得依核准量查核

事業單位之污染排放或使用情形，若有與前核准排放量不符者，可要求廠商應提出污染排放量變更申請資料辦理變更。如經查核年排放量仍超出核配量 10%或未達申請量 80%者，應提出說明，由服務中心研判後要求廠商配合增加污染防制設備以提升防制效率或進行原核配污染物總量之檢討。

2. 服務中心依據環保局許可量進行查核，若廠商排放量有遠低於許可量之情形，得要求廠商向環保局申請修正許可文件並收回超出之調撥量。
3. 若近 2 年內遭陳情次數達 3 次以上之廠商(包含本府各局處之陳情次數)，或認定有重大污染情形者，得收回超出之調撥量。
4. 廠商變更或展延許可文件時，若檢核原核配量有高於許可量之情形，得重新檢討核配量以收回調撥量。
5. 未來環保主管機關若有制定總量管制計畫，園區將配合進行排放量上限及管制措施之檢討改進，倘經主管機關認定需減量（包含 VOCs 減量／NOx 減量需求等）時，區內廠商應配合減量。

(八)「仁武產業園區資源或污染物排放總量管理原則」管制內容未來有變更時，區內廠商應依申請污染物排放量時之最新規定辦理。

參、環境回饋金計算方式

因廠商向本園區申請資源或污染物總量調撥時，依上述說明須配合提出環境回饋金，計算方式說明如下：

(一)各項目單位費率

為使廠商能自主性檢討並降低其污染調撥量，擬訂環境回饋金單位費率如表 1，未來本府如有調整應依最新費率執行。

表 1 環境回饋金單位費率

污染物名稱	單位費率(每年)
總懸浮微粒	55,000 元/公噸
氮氧化物	12,500 元/公噸
揮發性有機物	35,000 元/公噸

一般事業廢棄物	2,700 元/公噸
有害事業廢棄物	10,000 元/公噸
用水量或污水量[1]	與污水處理系統使用費費率一併擬訂
溫室氣體	340 元/公噸

(二)環境回饋金計算公式制定：

環境回饋金計算公式如下：

每年所需環境回饋金＝各項目單位費率×調撥量

在不超過環評總量之前提下，申請調撥量已自費購買抵換量部分，免予繳納回饋金，避免重複課予義務，然廠商應提出已自費購買抵換量之佐證資料。

環境回饋金本府得依每公頃投資金額超出 2 億元/公頃之比例給予折扣。

(三)環境回饋金繳納方式

1.繳納方式：由服務中心依各項污染物調撥量計算後，發出繳費通知廠商，廠商以年繳方式辦理，調撥期滿如須續借需於到期一個月前提出申請並完成繳費作業，繳款至「高雄市產業園區開發管理基金」帳戶。

2.因整體綜合考量，由本府要求歸還或配合調整調撥量時，本府將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿一個月者以一個月計算)退還廠商。

附件 1-1

仁武產業園區入區廠商資源或污染物總量管制審查表											
廠商名稱：						租/購地面積：					
污染物	總懸浮微粒(公噸/年)	PM_{10} (公噸/年)	$PM_{2.5}$ (公噸/年)	氮氧化物 (公噸/年)	揮發性有機化合物 (公噸/年)	用水量 (公噸/日)	廢水量 (公噸/日)	一般事業廢棄物 (公噸/日)	有害事業廢棄物 (公噸/日)	用電量 (仟瓦)	溫室氣體二氧化碳(燃料) (公噸/年)
該公司租/購地核配基準											
設廠產生量											
是否超出核配基準											
調撥量											
同意核配量											
有關廢水部分需另依仁武產業園區污水下水道排入限值及相關規定，申請納管取得許可後接管排放。											
審查結果：（本欄由審查機關填寫）											

附件 2-1

名稱	園區總量管制及污染減量廠商申請文件審查標準作業程序

一、定義：指入區、併購廠商及已核准進駐廠商以函文方式，進行資源或污染物總量管制之申請、變更等相關作業。

二、適用對象：入區、併購廠商及已核准進駐廠商。

三、法規依據：空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、廢棄物清理法、環境影響評估法及其他相關規定等。

四、作業內容

（一）園區廠商以函文方式，檢附相關申請資料乙式 2 份，提出資源或污染物總量管制之申請或變更。

（二）相關資料由服務中心負責受理及審查，惟本園區開發期間，服務中心尚未成立前，由本園區受託審查單位(開源營造股份有限公司)代為執行。

（三）由服務中心或負責審查單位進行文件審查作業，審查期限及作業流程如下：

1.由廠商提出申請文件後，需於 5 工作日內完成初審作業並將審查意見知會廠商。

2.於初審階段，如有資料缺漏、內容誤植或不符合相關規定等情形，則要求廠商進行資料補正。

3.俟廠商以書面、傳真、E-mail 等方式進行資料補正後，需於 3 工作日內完成複審作業。

4.各階段之審查作業皆需填寫「仁武產業園區申請文件審查意見表」（如附件 2-2），並由審查人員簽名或蓋章（需加註審查日期）後，交由服務中心複審。

5.廠商申請文件總補正日數為一個月（補正次數以 3 次為限），如逾期未完成者（或補正次數超過 3 次），服務中心得以函文方式駁回申請文件。

6.各階段審查或補正作業之日數計算，皆不含起始日。

（四）資源或污染物總量管制審查作業要點：

1.依廠商提出之設廠基本資料，判定資源或污染物申請項目及數量之合理性。

2.如為資源或污染物總量變更，需要求廠商提供各項資源或污染物總量之計算方式，並檢視其正確性。

3.資源或污染物總量核配以不得超過本府規定之「核配基準」為原則，核配基準參見本園區出租/售手冊附件 3-2。

4.如廠商申請之資源或污染物總量有超出本園區「核配基準」之情形，則先評估其申請文件之合理性，及統計目前園區可用之調撥量及餘裕量，並將相關資料彙整後，另行簽辦。

5.於審查完成後，立即更新園區廠商資源或污染物核配量總表。

（五）於審查完成後，由服務中心以函文方式回覆廠商審查結果，並檢還申請書一份。

附件 2-2

仁武產業園區申請文件審查意見表

廠商名稱			
審查項目			
聯絡人		聯絡電話	

審查意見

協審單位：_____

審查人員：_____

附件 3

仁武產業園區資源或污染量調撥切結書

本公司_____，在不超過仁武產業園區資源使用或污染物排放總量前提下，向高雄市政府經濟發展局申請調撥資源或污染物核配量(總懸浮微粒：_____公噸/年、氮氧化物：_____公噸/年、揮發性有機物_____公噸/年、有害事業廢棄物：_____公噸/日、一般事業廢棄物：_____噸/日、用電量：_____仟瓦、溫室氣體(燃料)：_____公噸 CO_2/年)，並承諾基於使用者付費原則，於調撥期間願繳納環境回饋金，爾後如區內廠商或後續入區廠商有需求必要，應無條件歸還或配合調整調撥量，另繳納之環境回饋金將依比例原則歸還未使用期間之回饋金及調整調撥量後計算回饋金差額(以月為單位，未滿一個月者以一個月計算)。

此致

高雄市政府經濟發展局

公司:_____

代表人:_____

中華民國_____年_____月_____日

附件 4

仁武產業園區資源或污染物總量管制排放減量切結書

本公司　　在法律處分之約束下，保證本公司取得資源或污染物調撥量後，於調撥核配量期間發生下列各項情事之一者，同意增加資源使用減量或污染防制設備以提升防制效率，或配合高雄市政府經濟發展局進行原核配資源或污染物總量之檢討：

1. 經查核資源或污染物之年平均使用或排放量若仍然超出許可核配量10%以上或未達許可核配量80%者。
2. 經查核未繳納環境回饋金者。
3. 園區資源或污染總量因環評變更有所變動時，同意核配量依租/購地面積等比例調整。

特此切結，此致

高雄市政府經濟發展局

立切結書人：

身份證字號：

事業名稱：

地址：

電話：

中華民國　　年　　月　　日

第三部分　土地出租位置

捌、仁武產業園區產業用地(一)土地出租位置



產

業用地(一)土地出租位置圖

註：本次公告出租編號 B02、D02 及 D03 等三坵塊。

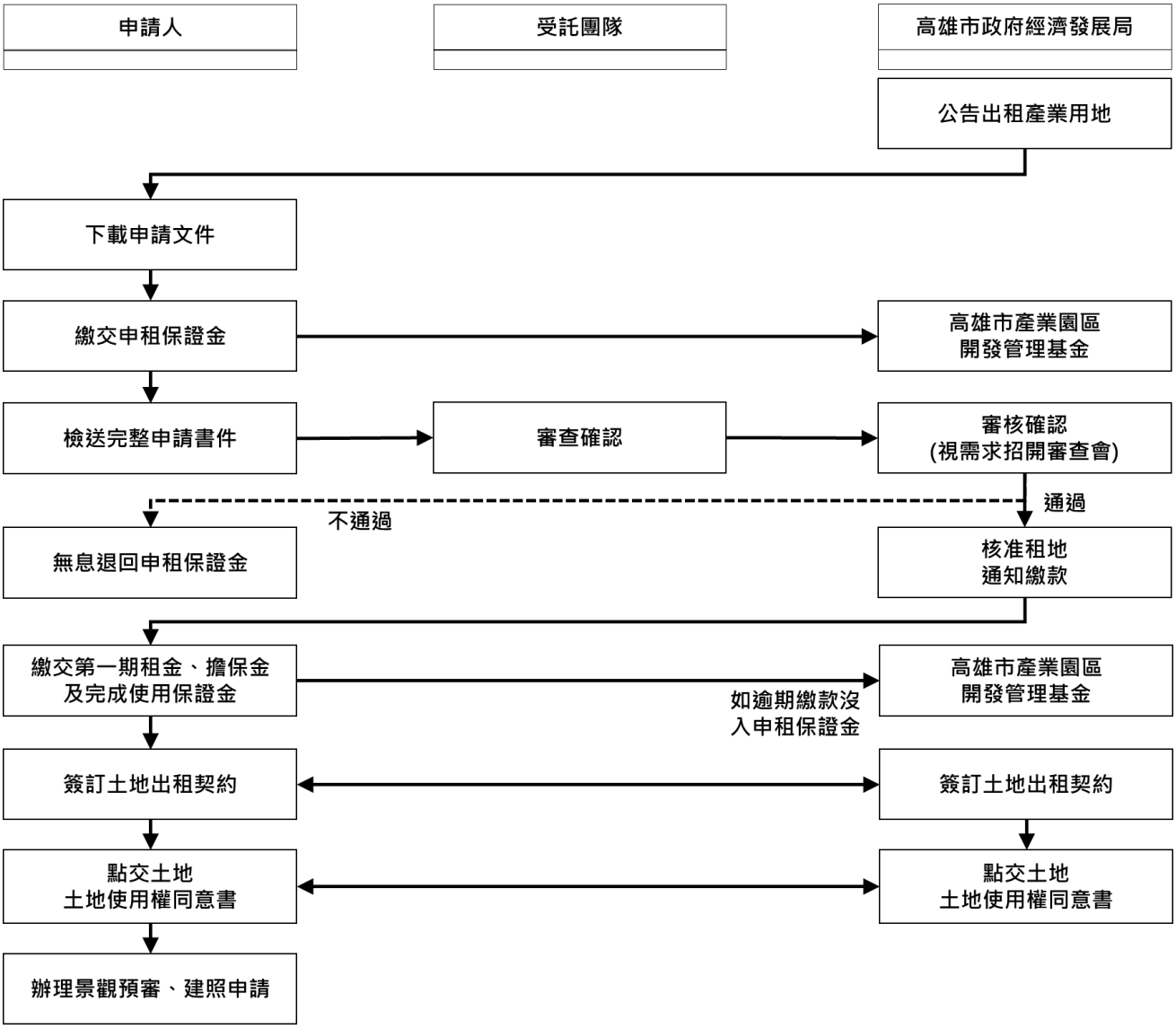
仁武產業園區產業用地(一)土地出租面積及保證金

坵塊編號	面積(平方公尺)	面積(坪)	申租保證金(元)	完成使用保證金(元)
B02	8,922	2,699	151,512	10,100,784
D02	1,825	552	30,988	2,065,824
D03	1,825	552	30,988	2,065,824

註：本次公告出租編號 B02、D02 及 D03 等三坵塊，本表所列面積係依都市計畫圖量測，未來實際面積應以地籍整理後地政機關土地登記簿之記載為準。

第四部分　申租流程及應備書件

玖、仁武產業園區產業用地(一)土地出租作業流程



拾、指定繳款行庫帳戶一覽表

款項類別	帳戶名稱	帳戶帳號
產業園區開發管理基金	高雄市政府經濟發展局產業園區開發管理基金	高雄銀行公庫部 102103032960